

(19)



**Евразийское
патентное
ведомство**

(11) **042626**

(13) **B1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ ПАТЕНТУ**

(45) Дата публикации и выдачи патента
2023.03.07

(51) Int. Cl. **G21B 1/05** (2006.01)
H01J 7/24 (2006.01)

(21) Номер заявки
201991117

(22) Дата подачи заявки
2017.11.06

(54) **СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕННОГО ПОДДЕРЖАНИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ КОНФИГУРАЦИИ С ОБРАЩЕННЫМ ПОЛЕМ С
ВАКУУМИРОВАНИЕМ С ЗАХВАТОМ МНОГОМАСШТАБНОГО ТИПА**

(31) **62/418,119**

(56) CA-A-2855698
US-A1-20060267504
US-A-3339106

(32) **2016.11.04**

(33) **US**

(43) **2019.09.30**

(86) **PCT/US2017/060255**

(87) **WO 2018/085798 2018.05.11**

(71)(73) Заявитель и патентовладелец:
ТАЭ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ИНК. (US)

(72) Изобретатель:
Ван Дри Алан (US)

(74) Представитель:
Медведев В.Н. (RU)

(57) Предложены системы и способы, которые облегчают формирование и поддержание FRC с превосходной устойчивостью, а также превосходным удержанием частиц, энергий и потока, а конкретнее - системы и способы, которые облегчают формирование и поддержание FRC с повышенными энергиями системы и улучшенное поддержание с использованием вакууммирования с захватом многомасштабного типа.

042626

B1

042626
B1

Область изобретения

Объект изобретения, описанный здесь, относится в целом к системам магнитного удержания плазмы, имеющим конфигурацию с обращенным полем (FRC), более конкретно - к системам и способам, которые облегчают формирование и поддержание FRC с повышенными энергиями системы и улучшенное поддержание с использованием вакууммирования с захватом многомасштабного типа.

Предпосылки изобретения

Конфигурация с обращенным полем (FRC) принадлежит классу топологий магнитного удержания плазмы, известных как компактные тороиды (КТ). Она демонстрирует преимущественно полоидальные магнитные поля и обладает нулевыми или малыми самогенерируемыми тороидальными полями (см. M. Tuszewski, Nucl. Fusion 28, 2033 (1988)). Преимуществами такой конфигурации являются ее простая геометрия для удобства построения и обслуживания, естественный неограниченный дивертор для облегчения вывода энергии и золоудаления и очень высокое β (β - это отношение среднего давления плазмы к среднему давлению магнитного поля внутри FRC), т.е. высокая плотность энергии. Природа высокого β является преимущественной для экономичной работы и для использования передовых, анейтронных видов топлива, таких как D-He³ и p-B¹¹.

Традиционный способ формирования FRC предусматривает применение технологии θ -пинча с обращенным полем, дающей горячие высокоплотные плазмы (см. A.L. Hoffman and J.T. Slough, Nucl. Fusion 33, 27 (1993)). Разновидностью этого является способ переноса и захвата, при осуществлении которого плазму, созданную в "источнике" тета-пинча, в большей или меньшей степени немедленно инжестируют из одного торца в камеру удержания. Затем осуществляют захват переносимого плазмоида между двумя прочными зеркалами на торцах камеры (см., например, H. Himura, S. Okada, S. Sugimoto, and S. Goto, Phys. Plasmas 2, 191 (1995)). Как только этот плазмодид оказывается в камере удержания, можно применять способы нагрева и возбуждения тока, такие как инжекция пучка частиц (нейтральных или нейтрализованных), вращающиеся магнитные поля, нагрев точками высокой частоты или омический нагрев и т.д. Это разделение функций источника и удержания дает ключевые инженерные преимущества для потенциальных будущих реакторов термоядерного синтеза. FRC доказали свою исключительную устойчивость к внешним воздействиям, приспособляемость к динамическому формированию, переносу и интенсивным событиям захвата. Более того, они демонстрируют тенденцию допускать предпочтительное состояние плазмы (см., например, H.Y. Guo, A.L. Hoffman, K.E. Miller, and L.C. Steinhauer, Phys. Rev. Lett. 92, 245001 (2004)). За последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в развитии других способов формирования FRC: посредством слияния сфероматов с противоположно направленными спиральностями (см., например, Y. Ono, M. Inomoto, Y. Ueda, T. Matsuyama, and T. Okazaki, Nucl. Fusion 39, 2001 (1999)) и посредством возбуждения тока вращающимися магнитными полями (ВМП) (см., например, I. R. Jones, Phys. Plasmas 6, 1950 (1999)), который также обеспечивает дополнительную устойчивость.

Недавно был существенно доработан метод столкновения и слияния, предложенный уже давно (см., например, D. R. Wells, Phys. Fluids 9, 1010 (1966)): два отдельных тета-пинча на противоположных торцах камеры удержания одновременно генерируют и ускоряют два плазмоида по направлению друг к другу на высокой скорости, которые затем сталкиваются в центре камеры удержания и сливаются, формируя составную FRC. При разработке и успешном проведении одного из наиболее крупномасштабных к настоящему времени экспериментов с FRC обычный способ столкновения и слияния показал, что дает устойчивые высокотемпературные FRC с большим временем жизни и большой плотностью потока частиц (см., например, M. Binderbauer, H.Y. Guo, M. Tuszewski et al., Phys. Rev. Lett. 105, 045003 (2010)).

FRC состоят из тора замкнутых силовых линий внутри сепаратрисы и кольцевого граничного слоя на незамкнутых силовых линиях только снаружи от сепаратрисы. Граничный слой сходится в струи за пределами длины FRC, обеспечивая естественный дивертор. Топология FRC совпадает с топологией плазмы зеркал с обращенным полем. Однако существенное различие заключается в том, что плазма FRC имеет β около 10. Собственное слабое внутреннее магнитное поле обеспечивает определенную местную популяцию частиц, обладающих определенной кинетической энергией, т.е. частиц с большими ларморовскими радиусами по сравнению с малым радиусом FRC. Очевидно, что именно эти сильные кинетические эффекты вносят по меньшей мере частичный вклад в общую устойчивость разработанных в прошлом и современных FRC, таких, как получаемые в эксперименте по столкновению и объединению.

В экспериментах с типичными FRC, разработанными в прошлом, доминировали конвективные потери, при этом удержание энергии определялось в значительной степени переносом частиц. Частицы диффундируют из ограниченного сепаратрисой объема главным образом радиально, а потом происходят их аксиальные потери в граничном слое. Соответственно, удержание FRC зависит от свойств областей как замкнутых, так и незамкнутых силовых линий поля. Время диффузии частиц наружу из объема, очерченного сепаратрисой, составляет $\tau_{\perp} \sim a^2/D_{\perp}$ ($a \sim r_c/4$ где r_c - центральный радиус сепаратрисы), а D_{\perp} - характеристический коэффициент диффузии, такой, как $D_{\perp} \sim 12,5\rho_{ie}$, причем ρ_{ie} представляет собой гиро-радиус ионов, оцениваемый в прикладываемом извне магнитном поле. В экспериментах с FRC, разработанных в прошлом, время τ_{\parallel} удержания частиц граничного слоя, по существу, представляет собой время осевого пробега. В установившемся состоянии баланс между радиальными и осевыми потерями частиц

дает длину градиента плотности у сепаратрисы, составляющую $\delta \sim (D_{\perp} \tau_{\parallel})^{1/2}$. Временные масштабы удержания частиц в FRC составляют $((\tau_{\perp} \tau_{\parallel})^{1/2})$ для FRC, разработанных в прошлом, которые имеют существенную плотность у сепаратрисы (см., например, M. Tuszewski, "Field Reversed Configurations," Nucl. Fusion 28, 2033 (1988)).

Поэтому, в свете вышеизложенного желательнее улучшить поддержание FRC, чтобы использовать FRC, работающие в установившемся состоянии, с помощью систем повышенной энергии как путь к активной зоне реактора для синтеза легких ядер с целью выработки энергии в будущем.

Сущность изобретения

Варианты осуществления настоящего изобретения, предложенные здесь, направлены на разработку систем и способов, которые облегчают формирование и поддержание FRC с повышенными энергиями системы и улучшенным поддержанием при использовании захвата многомасштабного типа. В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения способ генерирования и поддержания магнитного поля с конфигурацией с обращенным полем (FRC) содержит формирование FRC вокруг плазмы в камере удержания, инъекцию множества нейтральных пучков в плазму FRC под некоторым углом к средней плоскости камеры удержания, откачку молекулы нейтрализованного газа, аккумулируемых в первых и вторых диаметрально противоположных диверторах, связанных с камерой удержания, посредством первых и вторых захватывающих вакуумных насосов, расположенных в первых и вторых диверторах и содержащих две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, более чем в четыре (4) раза превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из двух или более сторон первых и вторых захватывающих вакуумных насосов содержит матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, в N раз превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов, причем N удовлетворяет неравенству $4 < N < 16$.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения поверхности плоской плиты и первых и вторых вакуумных насосов включают в себя осажденную на них пленку титана.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно включает в себя инъекцию плазм компактных тороидов (КТ) из первого и второго инжекторов КТ в плазму FRC под углом к средней плоскости камеры удержания, при этом первый и второй инжекторы КТ диаметрально противоположны, находясь с противоположных сторон от средней плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения захватывающий вакуумный насос содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, более чем в четыре (4) раза превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне захватывающего насоса.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из упомянутых двух или более сторон первых и вторых захватывающих вакуумных насосов содержит матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, в N раз превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов, причем N удовлетворяет неравенству $4 < N < 16$.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения поверхности плоской плиты и первых и вторых вакуумных насосов включают в себя осажденную на них пленку титана.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения предложена система для генерирования и поддержания магнитного поля с конфигурацией с обращенным полем (FRC), содержащая камеру удержания, первую и вторую диаметрально противоположные формирующие FRC секции, связанные с камерой удержания и включающие в себя первые и вторые захватывающие вакуумные насосы, расположенные в первых и вторых диверторах и содержащие две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, более чем в четыре (4) раза превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов, одну или более из множества плазменных пушек, один или более смещающих электродов и первую и вторую зеркальные пробки, причем упомянутое множество плазменных пушек включает в себя первую и вторую осевые плазменные пушки, функционально связанные с первыми и вторыми диверторами, первой и второй формирующими секциями и камерой удержания, при этом упомянутый один или более смещающих электродов расположены в пределах одной или более из камеры удержания, первой и второй формирующих секций и первого и второго внешних диверторов, и при этом упомянутые первая и вторая зеркальные пробки расположены между первой и второй формирующими секциями и первыми и вторыми диверторами, систему геттерирования, связанную с камерой удержания и первыми и вторыми диверторами, множество инжекторов нейтральных пучков, связанных с камерой удержания и наклоненных к средней плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения система дополнительно содержит первый и второй инжекторы компактных тороидов (КТ), связанные с камерой удержания, располагаясь под углом к средней плоскости камеры удержания, при этом первый и второй инжекторы КТ диаметрально противоположны, находясь с противоположных сторон от средней плоскости камеры удержания.

Системы, способы, признаки и преимущества возможных вариантов осуществления будут или станут очевидными специалисту в данной области техники после изучения следующих чертежей и подробного описания. Предполагается, что все такие дополнительные способы, признаки и преимущества должны быть заключены в пределах этого описания и защищены прилагаемой формулой изобретения. Также предполагается, что формула изобретения не ограничивается требованием деталей возможных вариантов осуществления.

Краткое описание чертежей

Сопроводительные чертежи, которые включены в данное описание как его часть, иллюстрируют предпочтительные в настоящее время возможные варианты осуществления и вместе с общим описанием, приведенным выше, и подробным описанием примерных вариантов осуществления, приведенным ниже, служат для объяснения принципов настоящего изобретения и обучения им.

Фиг. 1 иллюстрирует удержание частиц в настоящей системе FRC в высокоэффективном режиме FRC (HFRC) по сравнению с обычным режимом FRC (CR) и по сравнению с другими обычными экспериментами FRC.

Фиг. 2 иллюстрирует компоненты настоящей системы FRC и магнитную топологию FRC, получаемую в настоящей системе FRC.

Фиг. 3А иллюстрирует базовую схему расположения настоящей системы FRC на виде сверху, включая предпочтительное расположение центральной емкости для удержания, формирующей секции, диверторов, нейтральных пучков, электродов, плазменных пушек, зеркальных пробок и инжектора таблеток.

Фиг. 3В иллюстрирует центральную емкость для удержания на виде сверху и показывает нейтральные пучки, расположенные под прямым углом к главной оси симметрии центральной емкости для удержания.

Фиг. 3С иллюстрирует центральную емкость для удержания на виде сверху и показывает нейтральные пучки, расположенные под меньшим углом, чем прямой, к главной оси симметрии центральной емкости для удержания и направленные с возможностью инъекции частиц к средней плоскости центральной емкости для удержания.

Фиг. 3D и E иллюстрируют вид сверху и перспективное изображение, соответственно, базовой компоновки согласно альтернативному варианту осуществления предлагаемой системы FRC, включая предпочтительное расположение центральной емкости для удержания, формирующей секции, внутренних и внешних диверторов, нейтральных пучков, расположенных под меньшим углом, чем прямой, к главной оси симметрии центральной емкости для удержания, электродов, плазменных пушек, зеркальных пробок.

Фиг. 4 иллюстрирует схему компонентов системы импульсного питания для формирующих секций.

Фиг. 5 иллюстрирует изометрический вид отдельного формирующего модуля импульсного питания.

Фиг. 6 иллюстрирует изометрический вид узла формирующих труб.

Фиг. 7 иллюстрирует изометрический вид с частичным разрезом системы нейтральных пучков и ключевых компонентов.

Фиг. 8 иллюстрирует изометрический вид средств генерирования нейтральных пучков на камере удержания.

Фиг. 9 иллюстрирует изометрический вид с частичным разрезом предпочтительного расположения систем геттерирования Ti и Li.

Фиг. 10 иллюстрирует изометрический вид с частичным разрезом плазменной пушки, установленной в диверторной камере. Также показаны соответствующая магнитная зеркальная пробка и сборка диверторного электрода.

Фиг. 11 иллюстрирует предпочтительную схему расположения кольцевого смещающего электрода на осевом торце камеры удержания.

Фиг. 12 иллюстрирует эволюцию радиуса исключаемого потока в системе FRC, полученную исходя из серии внешних диамагнитных контуров на двух формирующих секциях тета-пинчей с обращенным полем и магнитных зондов, заделанных внутри центральной металлической камеры удержания. Время измеряется с момента синхронизируемого обращения поля в формирующих источниках, а расстояние z задается относительно осевой средней плоскости машины.

Фиг. 13A, B, C и D иллюстрируют данные от неподдерживаемого разряда в типичном не высокоэффективном режиме в настоящей системе FRC. Показаны как функции времени: фиг. 13A - радиус исключаемого потока на средней плоскости, фиг. 13B - 6 хорд линейно-интегрированной плотности из находящегося в средней плоскости интерферометра для определения содержания CO_2 , фиг. 13C - радиальные профили плотности, инвертированные по Абелю, по данным интерферометра для определения содержания CO_2 и фиг. 13D - общая температура плазмы исходя из баланса давления.

Фиг. 14 иллюстрирует осевые профили исключаемого потока в выбранные моменты времени для одного и того же разряда из настоящей системы FRC, показанной на фиг. 13A, 13B, 13C и 13D.

Фиг. 15 иллюстрирует изометрический вид отклоняющих катушек, установленных снаружи камеры удержания.

Фиг. 16A, B, C и D иллюстрируют корреляции времени жизни FRC и длительности импульсов инжектируемых нейтральных пучков. Как показано, более длительные импульсы пучков создают более долгоживущие FRC.

Фиг. 17A, B, C и D иллюстрируют отдельные и совокупные эффекты различных компонентов системы FRC на рабочие характеристики FRC и достижение высокоэффективного режима.

Фиг. 18A, B, C и D иллюстрируют данные из типичного высокоэффективного режима неподдерживаемого разряда в настоящей системе FRC. Показаны как функции времени: фиг. 18A - радиус исключаемого потока на средней плоскости, фиг. 18B - 6 хорд линейно-интегрированной плотности из находящегося в средней плоскости интерферометра для определения содержания CO_2 , фиг. 18C - радиальные профили плотности, инвертированные по Абелю, по данным интерферометра для определения содержания CO_2 и фиг. 18D - общая температура плазмы из баланса давления.

Фиг. 19 иллюстрирует удержание потока как функцию температуры (T_e) электронов. Это дает графическое представление о вновь устанавливаемом режиме масштабирования, который превосходит известные, для разрядов в высокоэффективном режиме.

Фиг. 20 иллюстрирует время жизни FRC, соответствующее длительности импульса ненаклонных и наклонных инжектируемых нейтральных пучков.

Фиг. 21A, B, C, D и E иллюстрируют длительность импульса наклонного нейтрального пучка и время жизни параметров плазмы FRC от радиуса плазмы, плотности плазмы, температуры плазмы и магнитного потока, соответствующее длительности импульса наклонных инжектируемых нейтральных пучков.

Фиг. 22A и B иллюстрируют базовую схему расположения инжектора компактных тороидов (КТ).

Фиг. 23A и B иллюстрируют центральную емкость для удержания, демонстрируя установленный на нее инжектор КТ.

Фиг. 24A и B иллюстрируют базовую схему расположения согласно альтернативному варианту осуществления инжектора КТ, имеющего связанную с ним дрейфовую трубку.

Фиг. 25 иллюстрирует изометрический вид в сечении активной зоны плазмы FRC и катушек постоянного тока камеры удержания, а также путь заряженных частиц, текущих из активной зоны плазмы FRC.

Фиг. 26 иллюстрирует изометрический вид дивертора.

На фиг. 27 представлен график, иллюстрирующий плотность нейтрального газа, накапливающегося во внутренних и внешних диверторах, в зависимости от времени в процессе эксплуатации предлагаемой системы FRC.

Фиг. 28 иллюстрирует изометрический вид объекта - отдельного насоса в виде куба с открытой гранью и плоской плиты, эквивалентной по размерам открытой грани куба.

На фиг. 29 представлен график, иллюстрирующий эффективный коэффициент прилипания согласно квадратному проему объекта - коробчатого насоса в зависимости от отношения глубины к ширине коробки при заданном коэффициенте прилипания для плоских поверхностей, которые образуют коробку.

Фиг. 30 иллюстрирует изометрический вид захватывающего насоса с самоподобными покрытыми поверхностями, содержащего куб с открытой стороной, образованный из сторон, содержащих матрицу отдельных насосов, содержащих куб с открытой гранью.

На фиг. 31 представлен график, иллюстрирующий увеличение эффективного коэффициента прили-

пания для захватывающего насоса с самоподобными покрытыми поверхностями в зависимости от дискретных уровней масштаба самоподобия.

Фиг. 32 иллюстрирует подробный изометрический вид, демонстрирующий уровни масштаба самоподобия для захватывающего насоса с самоподобными покрытыми поверхностями.

Следует отметить, что чертежи не обязательно выполнены в масштабе и что элементы подобных структур или функций обычно представлены одинаковыми ссылочными позициями на всех чертежах в целях иллюстрации. Следует также отметить, что чертежи предназначены только для облегчения описания различных вариантов осуществления, описанных здесь. На чертежах не обязательно описывается каждый аспект предлагаемых здесь идей, и чертежи не ограничивают объем притязаний согласно формуле изобретения.

Подробное описание

Варианты осуществления настоящего изобретения, предложенные здесь, направлены на разработку систем и способов, которые облегчают формирование и поддержание FRC, придавая им превосходную устойчивость, а также превосходное удержание частиц, энергии и потока. Некоторые из вариантов осуществления настоящего изобретения направлены на разработку систем и способов, которые облегчают формирование и поддержание FRC с повышенными энергиями системы и улучшенное поддержание с использованием вакуумирования с захватом многомасштабного типа.

Характерные примеры вариантов осуществления, описываемых здесь, примеры которых используют многие из этих дополнительных признаков и принципов, как по отдельности, так и в комбинации, будут теперь описаны подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи. Это подробное описание предназначено лишь для того, чтобы объяснить специалисту в области техники дополнительные детали для осуществления на практике предпочтительных аспектов принципов настоящего изобретения и не предназначено для ограничения объема притязаний изобретения. Поэтому комбинации признаков и этапов, раскрываемые в нижеследующем подробном описании, могут и не потребоваться для практического осуществления изобретения в самом широком смысле, а вместо этого поясняются, чтобы детально описать типичные примеры настоящих принципов.

Более того, различные признаки типичных примеров и зависимых пунктов формулы изобретения могут быть объединены способами, не перечисляемыми конкретно и в явном виде, с целью обеспечения дополнительных полезных вариантов осуществления принципов настоящего изобретения. Кроме того, четко указано, что все признаки, раскрытые в описании и/или формуле изобретения предназначены для раскрытия по отдельности и независимо друг от друга с целью первоначального раскрытия, а также с целью ограничения заявляемого объекта изобретения независимо от составов признаков в вариантах осуществления и/или формуле изобретения. Также явно видно, что все диапазоны значений или указания групп объектов раскрывают каждое возможное промежуточное значение или каждый промежуточный объект с целью первоначального раскрытия, а также с целью ограничения заявляемого объекта изобретения.

Прежде, чем обратиться к системам и способам, которые облегчают поддержание плазмы FRC с использованием вакуумирования с захватом многомасштабного типа, обсудим системы и способы формирования и поддержания высокоэффективных FRC, придавая им превосходную устойчивость, а также превосходное удержание частиц, энергии и потока по сравнению с обычными FRC. Такие высокоэффективные FRC обеспечивают путь к целому множеству приложений, включая компактные источники нейтронов (для производства изотопов медицинского назначения, ликвидации ядерных отходов, исследований материалов, нейтронной радиологии и томографии), компактные источники фотонов (для химического производства и обработки), системы разделения и обогащения изотопов, а также активные зоны реакторов для синтеза легких ядер с целью выработки энергии в будущем.

Чтобы оценить, существует ли режим удержания в FRC, превосходящий известные, исследованы различные вспомогательные системы и рабочие режимы. Эти усилия привели к важным научным открытиям и разработке парадигмы высокоэффективной FRC, описываемой здесь. В соответствии с этой новой парадигмой, настоящие системы и способы сочетают множество новых идей и средств для существенно улучшения удержания посредством FRC, как иллюстрируется на фиг. 1, а также обеспечивают управление устойчивостью без негативных побочных эффектов. Как подробно рассматривается ниже, фиг. 1 иллюстрирует удержание частиц в системе 10 FRC, описываемой ниже (см. фиг. 2 и 3), работающей в соответствии с высокоэффективным режимом FRC (HPF) для формирования и поддержания FRC по сравнению с работой в соответствии с обычным режимом RC (CR) для формирования и поддержания FRC и по сравнению с удержанием частиц в соответствии с обычными режимами формирования и поддержания FRC, используемыми в других экспериментах. В настоящем раскрытии будут приведены общее и подробное описания новых отдельных компонентов системы 10 FRC и способы, а также их совокупные эффекты.

Система FRC

Вакуумная система

На фиг. 2 и 3 иллюстрируется схематическое изображение настоящей системы 10 FRC. Система 10 FRC включает в себя центральную емкость 100 для удержания, окруженную двумя диаметрально противоположными формирующими секциями 200 тета-пинчей с обращенным полем, и две камеры 300 дивер-

торов, находящиеся вне формирующих секций 200 и предназначенные для контроля плотности нейтральных частиц и загрязнения примесями. Настоящая система 10 FRC была построена для обеспечения сверхвысокого вакуума и работает при типичных начальных давлениях $1,333 \times 10^{-6}$ Па (10^{-8} торр). Такие вакуумметрические давления требуют использовать стыковочные фланцы с двойной откачкой между стыкуемыми компонентами, металлические уплотнительные кольца, высокочистые внутренние стенки, а также тщательное начальное кондиционирование поверхностей всех деталей перед сборкой, такое, как физическая и химическая очистка с 24-часовой последующими вакуумной сушкой при 250°C и очисткой тлеющим разрядом в водороде.

Формирующие секции 200 тета-пинчей с обращенным полем представляют собой стандартные тета-пинчи с обращенным полем (FRTP), хотя и с усовершенствованной формирующей системой импульсного питания, подробно обсуждаемой ниже (см. фиг. 4-6). Каждая формирующая секция 200 выполнена из стандартных непрозрачных кварцевых труб промышленного класса, которые отличаются двухмиллиметровой внутренней футеровкой из сверхчистого кварца. Камера 100 удержания выполнена из нержавеющей стали для обеспечения множества радиальных и тангенциальных отверстий; она также служит в качестве консерватора потока во временном масштабе экспериментов, описанных ниже, и ограничивает быстрые магнитные переходные процессы. Вакуумы создаются и поддерживаются в пределах системы 10 FRC с помощью набора безмасляных спиральных форвакуумных насосов, турбомолекулярных насосов и крионасосов.

Магнитная система

На фиг. 2 и 3 проиллюстрирована магнитная система 400. На фиг. 2 среди прочих признаков иллюстрируются профили магнитного потока и плотности FRC (как функции радиальных и осевых координат), свойственные FRC 450, производимой посредством системы 10 FRC. Эти профили получены с помощью двумерного численного холловского МГД-моделирования с использованием кода, разработанного для моделирования систем и способов, соответствующих системе 10 FRC, и хорошо согласуются с измеренными экспериментальными данными. Как видно на фиг. 2, FRC 450 состоит из тора замкнутых силовых линий во внутренней части 453 FRC 450 внутри сепаратрисы 451 и кольцевого граничного слоя 456 на незамкнутых силовых линиях 452 сразу же за пределами сепаратрисы 451. Граничный слой 456 сливается в струи 454 за пределами длины FRC, обеспечивая естественный дивертор.

Главная магнитная система 410 включает в себя ряд катушек 412, 414 и 416 квазипостоянного тока, которые расположены в конкретных осевых положениях вдоль компонентов, т.е. вдоль камеры 100 удержания, формирующих секций 200 и диверторов 300 системы 10 FRC. Катушки 412, 414 и 416 квазипостоянного тока питаются от импульсных источников питания квазипостоянного тока и создают базовые подмагничивающие поля величиной примерно 0,1 Тл в камере 100 удержания, формирующих секциях 200 и диверторах 300. В дополнение к катушкам 412, 414 и 416 квазипостоянного тока главная магнитная система 410 включает в себя зеркальные катушки 420 квазипостоянного тока (запитанные от импульсных источников) между каждым торцом камеры 100 удержания и соседними формирующими секциями 200. Зеркальные катушки 420 квазипостоянного тока обеспечивают коэффициенты отражения магнитного зеркала вплоть до 5 и могут быть независимо возбуждены для контроля формы равновесия. Кроме того, зеркальные пробки 440 расположены между каждой из формирующих секций 200 и диверторами 300. Зеркальные пробки 440 содержат компактные зеркальные катушки 430 квазипостоянного тока и катушки 444 зеркальной пробки. Зеркальные катушки 430 квазипостоянного тока включают в себя три катушки 432, 434 и 436 (запитанные от импульсных источников), которые создают дополнительные направляющие поля для фокусировки поверхностей 455 магнитного потока к каналу 442 малого диаметра, проходящему через катушки 444 зеркальной пробки. Катушки 444 зеркальной пробки, которые намотаны вокруг канала 442 малого диаметра и питаются от LC-схемы импульсного питания, создают сильные поля магнитного зеркала вплоть до 4 Тл. Цель всей этой схемы расположения катушек состоит в том, чтобы плотно связывать и направлять поверхности 455 магнитного потока и текущие к торцу струи 454 плазмы в отдаленные камеры 310 диверторов 300. Наконец, набор "антенн" 460 отклоняющих катушек (см. фиг. 15) расположен снаружи камеры 100 удержания, по две с каждой стороны средней плоскости, и запитан от источников питания постоянного тока. Антенны 460 отклоняющих катушек могут быть выполнены так, чтобы обеспечить квазистатическое магнитное дипольное или квадрупольное поле величиной примерно 0,01 Тл для управления вращательными неустойчивостями и/или управлением током электронов. Антенны 460 отклоняющих катушек могут гибко обеспечивать магнитные поля, которые либо симметричны, либо антисимметричны относительно средней плоскости машины в зависимости от направления подаваемых токов.

Формирующие системы импульсного питания

Формирующие системы 210 импульсного питания работают по принципу модифицированного тета-пинча. Имеются две системы, каждая из которых питает одну из формирующих секций 200. На фиг. 4-6 иллюстрируются главные составляющие блоки и расположение формирующих систем 210. Формирующая система 210 состоит из модульной конструкции импульсного питания, которая состоит из отдельных блоков (модулей) 220, каждый из которых возбуждает поднабор катушек 232 (подвесок) узла 230 под-

вески, которые обвиты вокруг формирующих кварцевых труб 240. Каждый модуль 220 состоит из конденсаторов 221, индукторов 223, быстродействующих силовых переключателей 225 и связанных с ними панелей 222 запуска и 224 сброса заряда. Каждая формирующая система 210 запасает емкостную энергию в диапазоне 350-400 кДж, которая обеспечивает до 35 ГВт мощности для формирования и ускорения FRC. Координированная работа этих компонентов достигается посредством известной системы 222 и 224 запуска и управления, которая обеспечивает синхронизацию между формирующими системами 210 на каждой формирующей секции 200 и минимизирует неустойчивую синхронизацию переключения, ограничивая ее десятками наносекунд. Преимуществом этой модульной конструкции является гибкая работа: FRC могут быть сформированы на месте, а затем ускорены и инжектированы (= статическое формирование), или сформированы и ускорены одновременно (= динамическое формирование).

Инжекторы нейтральных пучков

Нейтральные пучки 600 атомов развертывают в системе 10 FRC для обеспечения нагрева и возбуждения тока, а также для развития давления быстрых частиц. Как показано на фиг. 3А, 3Б и 8, отдельные линии пучков, содержащие системы 610 и 640 инжекторов нейтральных пучков атомов, расположены вокруг центральной камеры 100 удержания и инжектируют быстрые частицы тангенциально в плазму FRC (и перпендикулярно или под углом, перпендикулярным к главной оси симметрии в центральной емкости 100 для удержания) с прицельным параметром, чтобы целевая зона захвата лежала хорошо в пределах сепаратрисы 451 (см. фиг. 2). Каждая система 610 и 640 инжекторов способна инжектировать нейтральные пучки мощностью вплоть до 1 МВт в плазму FRC с энергиями частиц от 20 до 40 кэВ. Системы 610 и 640 основаны на многоапертурных источниках выделения положительных ионов и используют геометрическую фокусировку, инерционное охлаждение сеток выделения ионов и дифференциальную накачку. Помимо использования различных источников плазмы системы 610 и 640 в первую очередь различаются по своей физической конструкции, чтобы соответствовать своим соответствующим местам установки, обеспечивая возможности боковой и верхней инжекции. Типичные компоненты этих инжекторов нейтральных пучков показаны, в частности, на фиг. 7 для систем 610 боковых инжекторов. Как показано на фиг. 7, каждая отдельная система 610 нейтральных пучков включает в себя источник 612 ВЧ-плазмы на входном торце (он заменяется дуговым источником в системах 640) с магнитным экраном 614, закрывающим этот торец. Оптический источник ионов и ускоряющие сетки 616 связаны с источником 612 плазмы, а запорный клапан 620 расположен между оптическим источником ионов и ускоряющими сетками 616 и нейтрализатором 622. Отклоняющий магнит 624 и средство сброса 628 ионов расположены между нейтрализатором 622 и нацеливающим устройством 630 на выходном торце. Система охлаждения содержит две криогенные холодильные машины 634, две криопанели 636 и кожух 638 LN₂. Эта гибкая конструкция позволяет работать в широком диапазоне параметров FRC.

Альтернативная конфигурация для инжекторов 600 нейтральных пучков атомов состоит в инжекции быстрых частиц тангенциально в плазму FRC, но с углом A , меньшим 90° , относительно главной оси симметрии в центральной емкости 100 для удержания. Эти типы ориентации инжекторов 615 пучков показаны на фиг. 3С. Кроме того, инжекторы 615 пучков могут быть ориентированы так, чтобы инжекторы 615 пучков на любой стороне средней плоскости центральной емкости 100 для удержания инжектировали свои частицы к средней плоскости. Наконец, осевое положение этих систем 600 пучков может быть выбрано ближе к средней плоскости. Эти альтернативные варианты осуществления инжекции облегчают более сфокусированный вариант пополнения, который обеспечивает лучшую связь пучков и более высокую эффективность захвата инжектируемых быстрых частиц. Кроме того, в зависимости от угла и осевого положения это расположение инжекторов 615 пучков позволяет осуществлять более прямое и независимое управление осевым удлинением и другими характеристиками FRC 450. Например, инжекция пучков под небольшим углом A относительно главной оси симметрии емкости создаст плазму FRC с более длинной осевой протяженностью и более низкой температурой, в то время как выбор более перпендикулярного угла A приведет к аксиально более короткой, но более горячей плазме. Таким образом угол A инжекции и местоположение инжекторов 615 пучков могут быть оптимизированы для разных целей. Кроме того, такое регулирование угла и расположение инжекторов 615 пучков может позволить пучки повышенной энергии (что в целом более выгодно для выведения большей мощности с меньшей расходимостью пучка) быть инжектируемыми в более слабые магнитные поля, чем в противном случае было бы необходимо для захвата таких пучков. Это связано с тем фактом, что именно азимутальная составляющая энергии определяет масштаб орбит быстрых ионов (который постепенно уменьшается, поскольку угол инжекции относительно главной оси симметрии емкости уменьшается при постоянной энергии пучка). Кроме того, наклонная инжекция к средней плоскости с осевыми положениями пучков вблизи средней плоскости улучшает связь пучок-плазма, даже когда плазма FRC сжимается или иным образом сужается в осевом направлении во время периода инжекции.

Как показано на фиг. 3D и 3E, другая альтернативная конфигурация системы 10 FRC включает в себя внутренние диверторы 302 в дополнение к инжекторам 615 наклонных пучков. Внутренние диверторы 302 расположены между формирующими секциями 200 и камерой 100 удержания и выполнены и работают практически аналогично внешним диверторам 300. Внутренние диверторы 302, которые включают в себя быстрые переключающие магнитные катушки, в сущности, неактивны во время процесса форми-

рования, чтобы позволить формирующим FRC проходить через внутренние диверторы 302, когда формирующие FRC поступательно перемещаются к средней плоскости камеры 100 удержания. После прохождения формирующих FRC через внутренние диверторы 302 в камеру 100 удержания внутренние диверторы активируются для работы, по существу, аналогично внешним диверторам и изолируют камеру 100 удержания от формирующих секций 200.

Инжектор таблеток

Чтобы обеспечить средство для инъекции новых частиц и лучшего контроля запаса частиц FRC, в системе 10 FRC используется 12-тиствольный инжектор 700 таблеток (см., например, I. Vinyar et al, "Pellet Injectors Developed at PELIN for JET, TAE, and HL-2A," Proceedings of the 26th Fusion Science and Technology Symposium, 09/27 to 10/01 (2010)). Фиг. 3 иллюстрирует схему расположения инжектора 700 таблеток в системе 10 FRC. Цилиндрические таблетки ($D \sim 1$ мм, $L \sim 1-2$ мм) инжектируются в FRC со скоростью в диапазоне 150-250 км/с. Каждая отдельная таблетка содержит примерно 5×10^{19} атомов водорода, что сопоставимо с запасом частиц FRC.

Системы геттерирования

Хорошо известно, что нейтральный галоидный газ является серьезной проблемой во всех системах удержания. Процессы обмена зарядами и рециркуляции (высвобождения холодного примесного материала из стенки) могут оказывать пагубное воздействие на удержание энергии и частиц. Кроме того, любая значительная плотность нейтрального газа на границе или вблизи нее приведет к быстрым потерям или по меньшей мере значительному сокращению времени жизни инжектируемых частиц большой орбиты (высокой энергии) (термин "большая орбита" относится к частицам, имеющим орбиты в масштабе топологии FRC или по меньшей мере радиусы орбиты, намного превышающие масштаб характерной длины градиента магнитного поля) - факт, который наносит ущерб всем энергетическим применениям плазмы, включая синтез через дополнительный нагрев пучка.

Кондиционирование поверхностей является средством, с помощью которого отрицательное воздействие нейтрального газа и примесей можно контролировать или уменьшить в системе для удержания. С этой целью система 10 FRC, представленная здесь, использует системы 810 и 820 осаждения титана и лития, которые покрывают обращенные к плазме поверхности камеры (или емкости) для удержания и диверторов 300 и 302 пленками (толщиной в десятки микрометров) из Ti и/или Li. Эти покрытия получают методами осаждения из паровой фазы. Твердые Li и/или Ti испаряют и/или сублимируют и напыляются на близлежащие поверхности для формирования покрытий. Источниками являются атомные печи с направляющими соплами 822 (в случае Li) или нагретые сферы из твердого вещества с направляющим бандажом 812 (в случае Ti). Системы для испарения Li, как правило, работают в непрерывном режиме, в то время как сублиматоры Ti в большинстве случаев работают периодически между работой с плазмой. Рабочие температуры этих систем превышают 600°C для получения больших скоростей осаждения. Для обеспечения хорошего покрытия стенок необходимо множество стратегически расположенных систем выпаривания/сублимации. На фиг. 9 подробно иллюстрируется предпочтительное расположение систем 810 и 820 геттерирования и осаждения в системе 10 FRC. Покрытия действуют как геттерирующие поверхности и эффективно откачивают атомные и молекулярные водородные виды (H и D). Эти покрытия также уменьшают другие типичные примеси, такие, как углерод и кислород, до незначительных уровней.

Зеркальные пробки

Как указано выше, в системе 10 FRC применяются наборы зеркальных катушек 420, 430 и 444, показанных на фиг. 2 и 3. Первый набор зеркальных катушек 420 находится на двух осевых торцах камеры 100 удержания и независимо возбуждается от удерживающей, формирующей и диверторной катушек 412, 414 и 416 главной магнитной системы 410. Первый набор зеркальных катушек 420 способствует главным образом управлению и осевому расположению FRC 450 во время слияния и обеспечивает управление формой равновесия во время поддержания. Первый набор 420 зеркальных катушек создает номинально более сильные магнитные поля (примерно 0,4-0,5 Тл), чем центральное поле удержания, создаваемое центральными удерживающими катушками 412. Второй набор зеркальных катушек 430, который включает в себя три компактные зеркальные катушки 432, 434 и 436 квазипостоянного тока, находится между формирующими секциями 200 и диверторами 300 и возбуждается посредством общего импульсного источника питания. Зеркальные катушки 432, 434 и 436 вместе с более компактными импульсными зеркальными пробочными катушками 444 (питаемыми посредством емкостного источника питания) и физическим сужением 442 образуют зеркальные пробки 440, которые обеспечивают узкий канал с низкой газопроводностью с очень сильными магнитными полями (от 2 до 4 Тл при временах нарастания примерно 10-20 мс). Наиболее компактные импульсные зеркальные катушки 444 имеют компактные радиальные размеры, внутренний диаметр 20 см и аналогичную длину по сравнению с внутренним диаметром порядка метра и плоской конструкцией удерживающих катушек 412, 414 и 416. Назначение зеркальных пробок 440 многозначно: (1) катушки 432, 434, 436 и 444 плотно увязывают и направляют поверхности 455 магнитного потока и текущие к концу струи 454 плазмы в отдаленные диверторные камеры 300. Это гарантирует, что выходящие частицы достигают диверторов 300 надлежащим образом, и что существуют поверхности 455 непрерывного потока, которые прослеживаются от области 452 не-

замкнутых силовых линий центральной FRC 450 на всем пути до диверторов 300. (2) Физические сужения 442 в системе 10 FRC, через которые катушки 432, 434, 436 и 444 обеспечивают прохождение поверхностей 455 магнитного потока и струй 454 плазмы, создают препятствие для потока нейтрального газа из плазменных пушек 350, которые находятся в диверторах 300. Аналогичным образом сужения 442 предотвращают обратное течение газа от формирующих секций 200 к диверторам 300, тем самым уменьшая количество нейтральных частиц, которые необходимо вводить во всю систему 10 FRC, когда начинается запуск FRC. (3) Строго осевые зеркала, создаваемые катушками 432, 434, 436 и 444, уменьшают осевые потери частиц и, тем самым, уменьшают параллельную диффузию частиц на незамкнутых силовых линиях.

В альтернативной конфигурации, показанной на фиг. 3D и E, набор низкопрофильных обжимных катушек 421 представляет собой положения между внутренними диверторами 302 и формирующими секциями 200.

Осевые плазменные пушки

Потоки плазмы из пушек 350, установленных в камерах 310 диверторов 300, предназначены для улучшения рабочих характеристик устойчивости и нейтральных пучков. Пушки 350 установлены по оси внутри камер 310 диверторов 300, как проиллюстрировано на фиг. 3 и 10, и создают плазму, текущую вдоль незамкнутых линий 452 потока в диверторе 300 и по направлению к центру камеры 100 удержания. Пушки 350 работают при высокоплотном газовом разряде в канале из пакета шайб и предназначены для генерации нескольких килоампер полностью ионизированной плазмы в течение 5-10 мс. Пушки 350 включают в себя импульсную магнитную катушку, которая согласует выходной поток плазмы с требуемым размером плазмы в камере 100 удержания. Технические параметры пушек 350 характеризуются каналом, имеющим внешний диаметр от 5 до 13 см и внутренний диаметр вплоть до примерно 10 см, и обеспечивают ток разряда 10-15 кА при 400-600 В с внутренним магнитным полем пушки от 0,5 до 2,3 Тл.

Потоки плазмы пушек могут проникать в магнитные поля зеркальных пробок 440 и втекать в формирующую секцию 200 и камеру 100 удержания. Эффективность переноса плазмы через зеркальную пробку 440 увеличивается с уменьшением расстояния между пушкой 350 и пробкой 440 и за счет уширения и укорочения пробки 440. В приемлемых условиях каждая пушка 350 может доставлять приблизительно 10^{22} протонов в секунду через зеркальные пробки 440 от 2 до 4 Тл с высокими температурами ионов и электронов примерно от 150 до 300 эВ и примерно от 40 до 50 эВ соответственно. Пушки 350 обеспечивают значительное пополнение граничного слоя 456 FRC и улучшенное общее удержание частиц FRC.

Чтобы дополнительно увеличить плотность плазмы, можно было бы использовать газосепаратор, чтобы вдуть дополнительный газ в поток плазмы из пушек 350. Этот метод позволяет в несколько раз увеличить плотность инжектируемой плазмы. В системе 10 FRC газосепаратор, установленный в системе 10 КОП на обращенной к диверторам 300 стороне зеркальных пробок 440, улучшает пополнение граничного слоя 456 FRC, формирование FRC 450 и линейное связывание плазмы.

Задаваясь всеми регулируемыми параметрами, рассмотренными выше, а также учитывая возможность работы лишь с одной или двумя пушками, легко понять, что доступен широкий спектр рабочих режимов.

Смещающие электроды

Электрическое смещение незамкнутых поверхностей потока может обеспечить радиальные потенциалы, которые приводят к азимутальному движению $E \times B$, которое обеспечивает механизм управления, аналогичный повороту ручки, для управления вращением плазмы с незамкнутыми силовыми линиями, а также фактической активной зоны 450 FRC через сдвиг скорости. Для выполнения этого управления система 10 FRC использует различные электроды, стратегически размещенные в различных частях машины. Фиг. 3 изображает смещающие электроды, расположенные в предпочтительных местах в пределах системы 10 FRC.

В принципе, существует 4 класса электродов: (1) точечные электроды 905 в камере 100 удержания, которые контактируют с отдельными незамкнутыми силовыми линиями 452 на границе FRC 450 для обеспечения локальной зарядки, (2) кольцевые электроды 900 между камерой 100 удержания и формирующими секциями 200 для зарядки дальних граничных слоев 456 по азимутально-симметричной схеме, (3) пакеты концентрических электродов 910 в диверторах 300 для зарядки многочисленных концентрических слоев 455 потока (вследствие чего выбор слоев управляем посредством регулировки катушек 416 для регулировки магнитного поля диверторов, чтобы завершать требуемые слои 456 потока на соответствующих электродах 910) и, наконец, (4) аноды 920 (см. фиг. 10) самих плазменных пушек 350 (которые перехватывают внутренние незамкнутые поверхности 455 потока вблизи сепаратрисы FRC 450). Фиг. 10 и 11 показывают некоторые типичные конструкции для некоторых из них.

Во всех случаях эти электроды возбуждаются импульсными источниками питания или источниками питания постоянного тока при напряжениях вплоть до примерно 800 В. В зависимости от размера электрода и того, какие поверхности потока пересекаются, токи могут потребляться в килоамперном диапазоне.

Неподдерживаемая работа системы FRC - обычный режим

Стандартное формирование плазмы в системе 10 FRC следует хорошо разработанному методу тета-

пинча с обращенным полем. Типичный процесс запуска FRC начинается возбуждением катушек 412, 414, 416, 420, 432, 434 и 436 квазипостоянного тока для работы в установившемся состоянии. Затем RFTP-цепи импульсного питания формирующих систем 210 импульсного питания возбуждают катушки 232 импульсного питания быстро переключаемого магнитного поля для создания временного обращенного смещения величиной примерно $-0,05$ Тл в формирующих секциях 200. В этот момент заданное количество нейтрального газа при 9-20 psi (фунт/кв.дюйм) инжектируется в два формирующих объема, определяемых камерами 240 кварцевых труб (северной и южной) формирующих секций 200 через набор азимутально ориентированных продувочных клапанов на фланцах, расположенных на внешних торцах формирующих секций 200. Затем небольшое количество (\sim сотни килогерц) ВЧ-поля генерируется от набора антенн на поверхности кварцевых труб 240 для создания предварительной ионизации в форме локальных областей ионизации затравок в пределах столбов нейтрального газа. За этим следует применение тета-кольцевой модуляции на токе, возбуждающей катушки 232 импульсного питания быстро переключаемого магнитного поля, что приводит к более глобальной предварительной ионизации столбов газа. Наконец, основные банки импульсного питания формирующих систем 210 импульсного питания зажигаются для возбуждения катушек 232 импульсного быстро переключаемого магнитного поля для создания прямосмещенного поля величиной вплоть до 0,4 Тл. Этот этап может быть секвенирован по времени так, чтобы прямосмещенное поле генерировалось равномерно по всей длине формирующих труб 240 (статическое формирование), или так, чтобы последовательная перистальтическая модуляция поля достигалась вдоль оси формирующих труб 240 (динамическое формирование).

Во всем этом процессе формирования фактическое обращение поля в плазме происходит быстро, в пределах примерно 5 мкс. Мультигигаваттная импульсная мощность, подаваемая в формирующуюся плазму, легко создает горячие FRC, которые затем удаляются из формирующих секций 200 посредством применения либо последовательной во времени модуляции магнитного поля в переднем полупространстве (магнитная перистальтика), либо временно увеличенных токов в последних катушках наборов 232 катушек вблизи осевых внешних торцов формирующих труб 210 (формирование осевого градиента магнитного поля, который направлен аксиально к камере 100 удержания). Две (северная и южная) формирующие FRC, сформированные таким образом и ускоренные, затем расширяются в камеру 100 удержания большего диаметра, где катушки 412 квазипостоянного тока создают прямосмещенное поле для управления радиальным расширением и обеспечения равновесного внешнего магнитного потока.

Как только северная и южная формирующие FRC прибывают в окрестность средней плоскости камеры 100 удержания, эти FRC сталкиваются. Во время столкновения осевые кинетические энергии северной и южной формирующих FRC большей частью термализуются, поскольку FRC в конечном итоге сливаются в одну FRC 450. Большой набор средств диагностики плазмы доступен в камере 100 удержания для изучения равновесий FRC 450. Типичные рабочие условия в системе 10 FRC создают составные FRC с радиусами сепаратрисы примерно 0,4 м и осевой протяженностью примерно 3 м.

Дополнительными характеристиками являются внешние магнитные поля величиной примерно 0,1 Тл, плотности плазмы примерно 5×10^{19} м⁻³ и общая температура плазмы вплоть до 1 кэВ. Без какого-либо поддержания, т.е. без нагрева и/или возбуждения тока посредством инъекции нейтральных пучков или других вспомогательных средств, время жизни этих FRC ограничивается примерно 1 мс, собственным характерным временем спада конфигурации.

Экспериментальные данные неподдерживаемой работы - обычный режим

Фиг. 12 показывает типичную временную эволюцию радиуса исключаемого потока, $r_{\Delta\phi}$, который аппроксимирует радиус сепаратрисы r_s , чтобы проиллюстрировать динамику процесса слияния тета-пинчей FRC 450. Два (северный и южный) отдельных плазмоида создаются одновременно и затем ускоряются из соответствующих формирующих секций 200 со сверхзвуковой скоростью, $v_z \sim 250$ км/с и сталкиваются вблизи средней плоскости при $z=0$. Во время столкновения плазмойды сжимаются аксиально с последующим быстрым радиальным и осевым расширением перед окончательным слиянием с образованием FRC 450. Как радиальная, так и осевая динамика слияния FRC 450 подтверждается подробными измерениями профиля плотности и томографией на основе болометра.

Данные из характерного неподдерживаемого разряда системы 10 FRC показаны как функции времени на фиг. 13A, 13B, 13C и 13D. FRC инициируется в момент $t=0$. Радиус исключаемого потока в средней вдоль оси плоскости машины показан на фиг. 13A. Эти данные получены из массива магнитных зондов, расположенных непосредственно внутри стенки камеры удержания из нержавеющей стали, которые измеряют осевое магнитное поле. Стальная стенка является хорошим консерватором потока на временных масштабах этого разряда.

На фиг. 13B показаны линейно интегрированные плотности, полученные от 6-ти хордового интерферометра для определения содержания $\text{CO}_2/\text{He-Ne}$, расположенного при $z=0$. С учетом вертикального (y) смещения FRC, измеренного с помощью болометрической томографии, инверсия по Абелю дает профили плотности согласно фиг. 13C. После некоторого осевого и радиального колебания в течение первых 0,1 мс FRC устанавливается с полым профилем плотности. Этот профиль довольно плоский, с существенной плотностью на оси, как того требуют равновесия типичных двумерных FRC.

На фиг. 13(D) показана общая температура плазмы, которая выведена исходя из баланса давления и полностью согласуется с томсоновским рассеянием и спектроскопическими измерениями.

Анализ всего массива исключаемого потока указывает на то, что форма сепаратрисы FRC (приближенная осевыми профилями исключаемого потока) постепенно эволюционирует от круговой к эллиптической. Эта эволюция, показанная на фиг. 14, согласуется с постепенным магнитным перезамыканием с переходом от двух к одной FRC. Действительно, грубые оценки позволяют предполагать, что в этот конкретный момент примерно 10% магнитных потоков двух первоначальных FRC перезамыкаются во время столкновения.

Длина FRC непрерывно сокращается от 3 до примерно 1 м в течение времени жизни FRC. Это сокращение, видимое на фиг. 14, позволяет предполагать, что при удержании FRC доминируют главным образом конвективные потери энергии. Поскольку давление плазмы внутри сепаратрисы уменьшается быстрее, чем внешнее магнитное давление, натяжение силовых линий магнитного поля в торцевых областях сжимает FRC аксиально, восстанавливая осевое и радиальное равновесие. Для разряда, рассмотренного на фиг. 13 и 14, магнитный поток, запас частиц и тепловая энергия (примерно 10 мВт, 7×10^{19} частиц и 7 кДж соответственно) FRC уменьшаются примерно на порядок по величине в первую миллисекунду, когда выявляется исчезновение равновесия FRC.

Поддерживаемая работа - высокоэффективный режим

На фиг. 12-14 приведены примеры, характеризующие разрушение FRC без какого-либо поддержания. Вместе с тем, в системе 10 FRC применяются несколько методов для дальнейшего улучшения удержания FRC (внутренней активной зоны и граничного слоя) для достижения высокоэффективного режима и поддержания конфигурации.

Нейтральные пучки

Сначала быстрые (H) нейтралы инжектируются перпендикулярно B_z в пучках из восьми инжекторов 600 нейтральных пучков. Пучки быстрых нейтралов инжектируются с момента, когда северная и южная формирующие FRC сливаются в камере 100 удержания в одну FRC 450. Быстрые ионы, создаваемые в основном перезарядкой, имеют бетатронные орбиты (с первичными радиусами на масштабе топологии FRC или по меньшей мере намного большими, чем масштаб характерной длины градиента магнитного поля), которые увеличивают азимутальный ток FRC 450. После некоторой доли разряда (после 0,5 до 0,8 мс на снимке) достаточно большая популяция быстрых ионов значительно улучшает свойства стабильности и удержания внутренних FRC (см., например, M.W. Binderbauer and N. Rostoker, *Plasma Phys.* 56, part 3, 451 (1996)). Кроме того, с точки зрения поддержания пучки от инжекторов 600 нейтральных пучков также являются основным средством для возбуждения тока и нагрева плазмы FRC.

В режиме плазмы системы 10 FRC быстрые ионы замедляются в основном на электронах плазмы. В течение ранней части разряда типичные усредненные по орбите времена замедления быстрых ионов составляют 0,3-0,5 мс, что приводит к значительному нагреву FRC, прежде всего электронами. Быстрые ионы совершают большие радиальные экскурсы наружу от сепаратрисы, поскольку внутреннее магнитное поле FRC по своей природе является слабым (примерно 0,03 Тл в среднем для внешнего осевого поля в 0,1 Тл). Быстрые ионы были бы уязвимы к потерям перезарядки, если бы плотность нейтрального газа была слишком высокой снаружи от сепаратрисы. Таким образом, геттерирование стенок и другие методы (такие как плазменная пушка 350 и зеркальные пробки 440, которые вносят вклад, помимо прочего, в управление газом), развернутые в системе 10 FRC, как правило, минимизируют граничные нейтралы и обеспечивают требуемое нарастание тока быстрых ионов.

Инъекция таблеток

Когда значительная популяция быстрых ионов вырастает внутри FRC 450 с более высокими температурами электронов и более длительными временами жизни FRC, замороженные таблетки H или D инжектируются в FRC 450 из инжектора 700 таблеток для поддержания запаса частиц FRC в FRC 450. Ожидаемые временные рамки абляции являются достаточно короткими, чтобы обеспечить значительный источник частиц FRC. Эта скорость также может быть увеличена за счет увеличения площади поверхности инжектируемой части путем разбиения отдельной таблетки на более мелкие фрагменты во время нахождения в цилиндрах или инжекционных трубах инжектора 700 таблеток и перед входом в камеру 100 удержания, этап, который может быть осуществлен путем увеличения трения между таблеткой и стенками инжекционной трубы посредством затяжки радиуса изгиба последнего сегмента инжекционной трубы прямо перед входом в камеру 100 удержания. За счет изменения последовательности и скорости зажигания 12 цилиндров (инжекционных труб), а также фрагментации, можно настроить систему 700 инъекции таблеток для обеспечения как раз требуемого уровня поддержания запаса частиц. В свою очередь, это помогает поддерживать внутреннее кинетическое давление в FRC 450 и самоподдерживающийся режим и время жизни FRC 450.

Как только подвергнутые абляции атомы сталкиваются со значительной плазмой в FRC 450, они становятся полностью ионизированными. Получающийся в результате компонент холодной плазмы затем столкновительно нагревается собственной плазмой FRC. Энергия, необходимая для поддержания требуемой температуры FRC, в конечном итоге поставляется инжекторами 600 пучков. В этом смысле инжекторы 700 таблеток вместе с инжекторами 600 нейтральных пучков образуют систему, которая под-

держивает установившееся состояние и поддерживает FRC 450.

Инжектор КТ

В качестве альтернативы инжектору таблеток предлагается инжектор компактного тороида (КТ), в основном, для пополнения плазмы конфигураций с обращенным полем (FRC). Инжектор 720 СТ содержит намагниченную коаксиальную плазменную пушку (НКПП), которая, как показано на фиг. 22А и 22В, включает в себя коаксиальные цилиндрические внутренний и внешний электроды 722 и 724, катушку 726 смещения, расположенную внутри внутреннего электрода, и электрический разрыв 728 на конце, противоположном выпуску инжектора 720 КТ. Газ инжектируется через отверстие 730 для инъекции газа в пространство между внутренним и внешним электродами 722 и 724, и плазма типа сферомака генерируется из него путем разряда и выталкивается из пушки силой Лоренца. Как показано на фиг. 23А и 23В, пара инжекторов 720 КТ связаны с емкостью 100 для удержания вблизи и по противоположащим сторонам средней плоскости емкости 100 для инъекции СТ в центральную плазму FRC в пределах сосуда 100 для удержания. Выпускной конец инжекторов 720 КТ направлен к средней плоскости емкости 100 для удержания под углом к продольной оси емкости 100 для удержания, аналогично инжекторам 615 нейтральных пучков.

В альтернативном варианте осуществления инжектор 720 КТ, как показано на фиг. 24А и В, включает в себя дрейфовую трубу 740, содержащую вытянутую цилиндрическую трубу, связанную с выпускным концом инжектора 720 КТ. Как показано, дрейфовая труба 740 включает в себя катушки 742 дрейфовой трубы, расположенные вокруг и аксиально разнесенные вдоль трубы. Вдоль длины трубы изображено множество диагностических отверстий 744.

Преимущества инжектора 720 КТ: (1) контроль и регулируемость запаса частиц на инжектируемый КТ; (2) осаждается теплая плазма (вместо криогенных таблеток); (3) система может работать в режиме частоты повторения, чтобы обеспечить непрерывное пополнение; (4) система также может восстанавливать некоторый магнитный поток, поскольку инжектируемые КТ несут встроенное магнитное поле. В варианте осуществления для экспериментального использования внутренний диаметр внешнего электрода составляет 83,1 мм, а внешний диаметр внутреннего электрода составляет 54,0 мм. Поверхность внутреннего электрода 722 предпочтительно покрыта вольфрамом, чтобы уменьшить примеси, выходящие из электрода 722. Как показано, катушка 726 смещения установлена внутри внутреннего электрода 722.

В недавних экспериментах была достигнута сверхзвуковая скорость поступательного перемещения КТ вплоть до ~ 100 км/с. Другими типичными параметрами плазмы являются следующие: плотность электронов $\sim 5 \times 10^{21} \text{ м}^{-3}$, температура электронов $\sim 30\text{-}50$ эВ и запас частиц $\sim 0,5\text{-}1,0 \times 10^{19}$. Высокое кинетическое давление КТ позволяет инжектируемой плазме проникать глубоко в FRC и осаждают частицы внутри сепаратрисы. В недавних экспериментах пополнение частиц FRC дало такой результат, что $\sim 10\text{-}20\%$ запаса частиц FRC, обеспечиваемого инжекторами КТ, успешно демонстрирующими пополнение, могут быть легко проведены без нарушения плазмы FRC.

Отклоняющие катушки

Для достижения возбуждения тока в установившемся состоянии и поддержания требуемого тока ионов желательно предотвращать или значительно уменьшать направленные вверх спины электронов, обусловленные силой трения между электронами и ионами (являющейся результатом переноса импульса ионно-электронного столкновения). Система 10 FRC использует инновационную методику для обеспечения электронного разрыва через прикладываемое извне статическое магнитное дипольное или квадрупольное поле. Это достигается посредством внешних отклоняющих катушек 460, изображенных на фиг. 15. Поперечно приложенное радиальное магнитное поле от отклоняющих катушек 460 индуцирует осевое электрическое поле во вращающейся плазме FRC. Результирующий осевой ток электронов взаимодействует с радиальным магнитным полем, создавая азимутальное разрывное воздействие на электроны $F_{\theta} = -\sigma V_{\theta} \langle |B_r|^2 \rangle$. Для типичных условий в системе 10 FRC требуемое прикладываемое магнитное дипольное (или квадрупольное) поле внутри плазмы должно быть лишь порядка 0,001 Тл для обеспечения адекватного электронного разрыва. Соответствующее внешнее поле величиной примерно 0,015 Тл является достаточно слабым, чтобы вызывать заметные потери быстрых частиц или иным образом отрицательно влиять на удержание. Фактически, прикладываемое магнитное дипольное (или квадрупольное) поле способствует подавлению неустойчивостей. В комбинации с тангенциальной инъекцией нейтральных пучков и осевой инъекцией плазмы отклоняющие катушки 460 обеспечивают дополнительный уровень контроля в отношении поддержания тока и устойчивости.

Зеркальные пробки

Конструкция импульсных катушек 444 в пределах зеркальных пробок 440 допускает локальную генерацию сильных магнитных полей (от 2 до 4 Тл) с помощью небольшой (примерно 100 кДж) емкостной энергии. Для формирования магнитных полей, типичных для предлагаемой эксплуатации системы 10 FRC, все силовые линии в пределах формирующего объема проходят через сужения 442 у зеркальных пробок 440, как это предполагается силовыми линиями магнитного поля на фиг. 2, и контакт плазмы со стенкой не происходит. Кроме того, зеркальные пробки 440 совместно с диверторными магнитами 416 квазипостоянного тока могут быть отрегулированы так, чтобы направлять силовые линии на дивертор-

ные электроды 910 или выставлять силовые линии в конфигурации торцевых выступов (не показана). Последняя повышает устойчивость и подавляет параллельную теплопроводность электронов.

Зеркальные пробки 440 сами по себе также способствуют контролю нейтрального газа. Зеркальные пробки 440 позволяют лучше использовать дейтериевый газ, вдуваемый в кварцевые трубы во время формирования FRC, поскольку поток газа, текущий обратно в диверторы 300, значительно уменьшается благодаря малой способности пробок пропускать газ (такой малой, как 500 л/с). Большая часть остаточного газа, продуваемого внутри формирующих труб 210, быстро ионизируется. Кроме того, высокоплотная плазма, протекающая через зеркальные пробки 440, обеспечивает эффективную ионизацию нейтралов, а следовательно - и эффективный газовый барьер. В результате большинство нейтралов, рециркулированных в диверторах 300 из граничного слоя 456 FRC, не возвращается в камеру 100 удержания. Кроме того, нейтралы, связанные с работой плазменных пушек 350 (как обсуждается ниже), будут в основном удерживаться в диверторах 300.

Наконец, зеркальные пробки 440 имеют тенденцию улучшать удержание граничного слоя FRC. С коэффициентами отражения зеркала (пробка/магнитные поля удержания) в диапазоне от 20 до 40 и при длине 15 м между северной и южной зеркальными пробками 440, время $\tau_{||}$ удержания частиц граничного слоя увеличивается на порядок величины. Улучшение $\tau_{||}$ легко увеличивает удержание частиц FRC.

Предполагая, что обуславливаемые радиальной диффузией (D) потери частиц из ограничиваемого сепаратрисой объема 453 уравновешены осевыми потерями ($\tau_{||}$) из граничного слоя 456, получаем $(2\pi r_c L_c)(Dn_c/\delta) = (2\pi r_c L_c \delta)(n_c/\tau_{||})$, откуда следует, что длину градиента плотности у сепаратрисы можно переписать в виде $\delta = (D\tau_{||})^{1/2}$. Здесь r_c , L_c и n_c - это радиус сепаратрисы, длина сепаратрисы и плотность у сепаратрисы, соответственно. Время удержания частиц в FRC составляет $\tau_N = [\pi r_c^2 L_c \langle n \rangle] / [(2\pi r_c L_c)(Dn_c/\delta)] = (\langle n \rangle / n_c)(\tau_{||} \tau_{\perp})^{1/2}$, где $\tau_{\perp} = a^2/D$ и при этом $a = r_c/4$. Физически, увеличение $\tau_{||}$ ведет к увеличенному δ (уменьшенному градиенту плотности и параметру дрейфа у сепаратрисы), а значит и к уменьшенным потерям частиц в FRC. Общее увеличение параметра удержания частиц в FRC обычно несколько меньше, чем квадратичное, поскольку n_c увеличивается вместе с $\tau_{||}$.

Значительное улучшение $\tau_{||}$ также требует того, чтобы граничный слой 456 оставался по большому счету устойчивым (т.е. чтобы при $n=1$ не было желобковой, рукавной или другой МГД-неустойчивости, характерной для открытых систем). Использование плазменных пушек 350 обеспечивает эту предпочтительную граничную неустойчивость. В этом смысле зеркальные пробки 440 и плазменная пушка 350 образуют эффективную систему контроля границы.

Плазменные пушки

Плазменные пушки 350 улучшают устойчивость выходящих струй 454 FRC посредством линейного связывания. Плазмы пушек, выпускаемые из плазменных пушек 350, генерируются без азимутального момента импульса, что оказывается полезным для борьбы с вращательными неустойчивостями FRC. Таким образом, пушки 350 являются эффективным средством для управления устойчивостью FRC без необходимости использования более старого метода квадрупольной стабилизации. В результате, плазменные пушки 350 позволяют использовать преимущества благоприятных эффектов быстрых частиц или получить доступ к режиму усовершенствованной гибридной кинетической FRC, как изложено в этом изобретении. Следовательно, плазменные пушки 350 позволяют системе 10 FRC работать с токами отклоняющих катушек, подходящими как раз для электронного разрыва, но ниже порога, который вызвал бы неустойчивость FRC и/или привел бы к интенсивной диффузии быстрых частиц.

Как упоминалось в рассмотренном выше разделе "Зеркальные пробки", если бы можно было значительно увеличить $\tau_{||}$, то подаваемая из пушек плазма была бы сопоставимой со скоростью ($\sim 10^{22}/c$) потерь частиц в граничном слое. Время жизни получаемой из пушек плазмы в системе 10 FRC находится в миллисекундном диапазоне. В самом деле, рассмотрим плазму из пушек, имеющую плотность $n_c \sim 10^{13} \text{ см}^{-3}$ и температуру ионов примерно 200 эВ, удерживаемую между торцовыми зеркальными пробками 440. Длина L захвата и коэффициент R отражения зеркала составляют примерно 15 м и 20, соответственно. Средняя длина свободного пробега ионов из-за кулоновских столкновений составляет $\lambda_{ii} \sim 6 \times 10^3 \text{ см}$, а поскольку $\lambda_{ii} \ln R / R < L$, ионы удерживаются в газодинамическом режиме. Время удержания плазмы в этом режиме составляет $\tau_{\text{сег}} \sim RL / 2V_c \sim 2 \text{ мс}$, где V_c - скорость ионного звука. Для сравнения, классическое время удержания ионов для этих параметров плазмы составляло бы $\tau_c \sim 0,5 \tau_{ii} (\ln R + (\ln R)^{0,5}) \sim 0,7 \text{ мс}$. Аномальная поперечная диффузия может, в принципе, сократить время удержания плазмы. Однако, если предположить, что в системе 10 FRC имеет место скорость диффузии Бома, то оценочное время поперечного удержания для плазмы из пушек составляет $\tau_{\perp} > \tau_{\text{сег}} \sim 2 \text{ мс}$. Следовательно, пушки обеспечили бы значительное пополнение граничного слоя 456 FRC с и улучшенное общее удержание частиц FRC.

Кроме того, потоки плазмы пушек могут быть включены примерно на 150-200 мкс, что позволяет использовать их при запуске, поступательном перемещении и слиянии FRC в камеру 100 удержания. Если включить примерно в $t \sim 0$ (инициирование основного банка FRC), плазма пушек поможет поддерживать предлагаемую динамически сформированную и слившуюся FRC 450. Объемные запасы частиц из формирующих FRC и из пушек удовлетворительны для захвата нейтральных пучков, нагрева плазмы и длительного поддержания. Если включить при t в диапазоне от -1 до 0 мс, плазма пушек может

заполнить кварцевые трубы 210 плазмой или ионизировать газ, вдутый в кварцевые трубы, что позволяет сформировать FRC с уменьшенным или даже, возможно, нулевым вдутым газом. Последнее может потребовать достаточно холодной формирующей плазмы, чтобы обеспечить быструю диффузию магнитного поля с обратным смещением. Если включить при $t < -2$ мс, потоки плазмы могут заполнить объем силовых линий от 1 до 3 м³ областей формирования и удержания формирующих секций 200 и камеры 100 удержания с целевой плотностью плазмы в несколько единиц на 10¹³ см⁻³, достаточной для обеспечения нарастания нейтральных пучков до прибытия FRC. Затем формирующие FRC могут быть сформированы и поступательно перемещены в результирующую плазму емкости для удержания. Таким образом, плазменные пушки 350 обеспечивают широкий спектр рабочих условий и режимов параметров.

Электрическое смещение

Управление профилем радиального электрического поля в граничном слое 456 выгодно различными способами для обеспечения устойчивости и удержания FRC. Благодаря инновационным смещающим компонентам, развернутым в системе 10 FRC, можно прикладывать множество заблаговременно подготовленных распределений электрических потенциалов к группе незамкнутых поверхностей потока по всей машине из областей далеко снаружи центральной области удержания в камере 100 удержания. Таким образом, радиальные электрические поля могут быть сгенерированы через граничный слой 456, расположенный сразу же за FRC 450. Эти радиальные электрические поля затем модифицируют азимутальное вращение граничного слоя 456 и осуществляют его удержание через сдвиг скорости $E \times B$. Любое дифференциальное вращение между граничным слоем 456 и активной зоной 453 FRC может затем передаваться внутрь плазмы FRC посредством сдвига. В результате управление граничным слоем 456 непосредственно воздействует на активную зону 453 FRC. Кроме того, поскольку свободная энергия при вращении плазмы также может быть причиной неустойчивостей, этот метод обеспечивает прямое средство для управления возникновением и ростом неустойчивостей. В системе 10 FRC надлежащее граничное смещение обеспечивает эффективное управление транспортировкой и вращением незамкнутых силовых линий, а также вращением активной зоны FRC. Расположение и форма различных предусмотренных электродов 900, 905, 910 и 920 позволяет управлять различными группами поверхностей 455 потока и при разных и независимых потенциалах. Таким образом, может быть реализован широкий спектр разных конфигураций электрических полей и напряженностей, каждая из которых имеет разное характерное влияние на рабочие характеристики плазмы.

Ключевым преимуществом всех этих инновационных методов смещения является тот факт, что на поведение плазмы активной зоны и границы можно влиять из мест далеко снаружи плазмы FRC, т.е. нет необходимости приводить какие-либо физические компоненты в контакт с центральной горячей плазмой (что имело бы серьезные последствия для потерь энергии, потока и частиц). Это имеет существенное благоприятное воздействие на рабочие характеристики и все потенциальные применения концепции высокоэффективного режима.

Экспериментальные данные - работа в высокоэффективном режиме Инжекция быстрых частиц посредством пучков из пушек 600 нейтральных пучков играет важную роль в обеспечении высокоэффективного режима. Фиг. 16A, 16B, 16C и 16D иллюстрируют этот факт. Изображен набор кривых, показывающих, как время жизни FRC коррелируется с длительностью импульсов пучков. Все другие рабочие условия поддерживаются неизменными для всех разрядов, охватываемых этим исследованием. Данные усредняются по многим выстрелам и поэтому отображают типичное поведение. Совершенно очевидно, что увеличенная длительность пучков создает более долгоживущие FRC. Рассматривая эти данные, а также другие диагностические данные в ходе этого исследования, можно видеть, что пучки повышают стабильность и уменьшают потери. Корреляция между длиной импульсов пучков и временем жизни FRC не является совершенной, поскольку захват пучков становится неэффективным ниже определенного размера плазмы, т.е. по мере того, как FRC 450 сжимается в физическом размере, не все инжектированные пучки перехватываются и захватываются. Сокращение FRC происходит главным образом ввиду того факта, что чистые потери энергии (~4 МВт примерно на полпути через разряд) из плазмы FRC во время разряда несколько превышают общую мощность, подаваемую в FRC через нейтральные пучки (~2,5 МВт) для конкретного экспериментального запуска. Расположение пучков в месте, находящемся ближе к средней плоскости емкости 100, привело бы к уменьшению этих потерь и продлению времени жизни FRC.

Фиг. 17A, B, C и D иллюстрируют воздействия разных компонентов на достижение высокоэффективного режима. Здесь показано семейство типичных кривых, отображающих время жизни FRC 450 как функцию времени. Во всех случаях постоянная, небольшая величина мощности пучков (примерно 2,5 МВт) инжектируется на протяжении всей длительности каждого разряда. Каждая кривая представляет разную комбинацию компонентов. Например, работа системы 10 FRC без каких-либо зеркальных пробок 440, плазменных пушек 350 или геттерирования благодаря системам 800 геттерирования приводит к быстрому появлению вращательной неустойчивости и утрате топологии FRC. Введение только зеркальных пробок 440 задерживает появление неустойчивостей и улучшает удержание. Использование совокупности зеркальных пробок 440 и плазменной пушки 350 дополнительно уменьшает неустойчивости и увеличивает время жизни FRC. И, наконец, введение геттерирования (Ti в этом случае) вдобавок к пушке 350 и пробкам 440 дает наилучшие результаты - в получаемой FRC нет неустойчивостей, и она демонст-

рирует самое продолжительное время жизни. Из этой экспериментальной демонстрации ясно, что вся совокупность компонентов дает наилучший эффект и обеспечивает пучки с наилучшими целевыми условиями.

Как показано на фиг. 1, недавно открытый высокоэффективный режим демонстрирует значительно улучшенное поведение при переносе. Фиг. 1 иллюстрирует изменение времени удержания частиц в системе 10 FRC между обычным режимом и высокоэффективным режимом. Как видно, в высокоэффективном режиме оно улучшилось в более 5 раз. Кроме того, фиг. 1 детализирует время удержания частиц в системе 10 FRC относительно времени удержания частиц в обычных экспериментах FRC уровня техники. Что касается этих других машин, высокоэффективный режим системы 10 FRC улучшает удержание от 5 до почти 20 раз. Наконец, и что наиболее важно, характер масштабирования удержания системы 10 FRC в высокоэффективном режиме резко отличается от всех измерений уровня техники. До установления высокоэффективного режима в системе 10 FRC различные эмпирические законы масштабирования получали из данных для прогнозирования времен удержания в экспериментах FRC уровня техники. Все эти правила масштабирования зависят в основном от отношения R^2/ρ_i , где R - радиус нуля магнитного поля (нестрогая мера физического масштаба машины), а ρ_i - ларморовский радиус иона, вычисленный в прикладываемом извне поле (нестрогая мера прикладываемого магнитного поля). Из фиг. 1 ясно, что длительное удержание в обычных FRC возможно лишь при большом размере машины и/или сильном магнитном поле.

Работа системы 10 FRC в обычном режиме FRC имеет тенденцию следовать тем правилам масштабирования, как показано на фиг. 1. Однако высокоэффективный режим является значительно превосходящим и показывает, что гораздо лучшее удержание может быть достигнуто без большого размера машины или сильных магнитных полей. Что еще более важно, из фиг. 1 также ясно, что высокоэффективный режим приводит к улучшению времени удержания с уменьшенным размером плазмы по сравнению с обычным режимом. Аналогичные тенденции также видны для времен удержания потока и энергии, как описано ниже, которые также увеличились более чем в 3-8 раз в системе 10 FRC. Таким образом, прорыв высокоэффективного режима позволяет использовать небольшую мощность пучков, более слабые магнитные поля и меньший размер для поддержания и удержания равновесий FRC в системе 10 FRC и будущих машинах более высоких энергий. Этим улучшениям сопутствует меньшая стоимость эксплуатации и строительства, а также уменьшенная инженерная сложность.

Для дальнейшего сравнения на фиг. 18A, B, C и D показаны данные из типичного разряда высокоэффективного режима в системе 10 FRC как функции времени. Фиг. 18(A) изображает радиус исключаемого потока на средней плоскости. Для этих более длительных временных масштабов проводящая стальная стенка больше не является хорошим консерватором потока, и магнитные зонды, внутренние по отношению к стенке, дополняются зондами снаружи стенки, чтобы должным образом учитывать диффузию магнитного потока через сталь. По сравнению с типичными характеристиками в обычном режиме, как показано на фиг. 13A, B, C и D, режим работы, соответствующий высокоэффективному режиму, демонстрирует увеличенное более чем на 400% время жизни.

Типичный график следа линейно интегрированной плотности показан на фиг. 18B с его инвертированным по Абелю дополнением, профили плотности - на фиг. 18C. По сравнению с обычным режимом FRC, как показано на фиг. 13A, B, C и D, плазма является более статичной на протяжении всего импульса, что свидетельствует об очень устойчивой работе. Пиковая плотность также немного ниже при выстрелах высокоэффективного режима - это следствие более высокой общей температуры плазмы (вплоть до 2 раз), как показано на фиг. 18D.

Для соответствующего разряда, проиллюстрированного на фиг. 18A, B, C и D, времена удержания энергии, частиц и потока составляют 0,5 мс, 1 мс и 1 мс, соответственно. В момент начала отсчета 1 мс при вхождении в разряд, накопленная энергия плазмы составляет 2 кДж, в то время как потери составляют примерно 4 МВт, что делает этот целевой набор параметров весьма подходящим для поддержания нейтральных пучков.

Фиг. 19 суммирует все преимущества высокоэффективного режима в виде недавно установленного экспериментального масштабирования удержания потока высокоэффективного режима. Как можно видеть на фиг. 19, на основе измерений, проведенных до и после $t=0,5$ мс, т.е. $t \leq 0,5$ мс и $t > 0,5$ мс, удержание потока (и аналогичным образом удержание частиц и удержание энергии) масштабируется примерно с квадратом температуры электронов (T_e) для заданного радиуса сепаратрисы (r_s). Это сильное масштабирование с положительной степенью T_e (а не с отрицательной степенью) полностью противоположно тому, которое проявляется обычными токамаками, где удержание, как правило, обратно пропорционально некоторой степени температуры электронов. Проявление этого масштабирования является прямым следствием состояния высокоэффективного режима и большой орбиты (т.е. орбит на масштабе топологии FRC и/или по меньшей мере характерном масштабе длины градиента магнитного поля). По сути, это новое масштабирование существенно благоприятствует высоким рабочим температурам и обеспечивает относительно небольшие по размеру реакторы.

Благодаря наличию преимуществ высокоэффективного режима достижимо поддержание FRC или

установившееся состояние, возбуждаемое нейтральными пучками, что означает, что глобальные параметры плазмы, такие как тепловая энергия плазмы, общие количества частиц, радиус и длина плазмы, а также магнитный поток являются поддерживаемыми на приемлемых уровнях без существенного спада. Для сравнения фиг. 20 показывает данные на графике А, полученные в результате разряда в типичном высокоэффективном режиме в системе 10 FRC как функция времени, а на графике В - для спроектированного разряда типичного высокоэффективного режима в системе 10 FRC как функция времени, где FRC 450 поддерживается без спада на протяжении длительности импульса нейтральных пучков. Для графика А нейтральные пучки с общей мощностью в диапазоне примерно 2,5-2,9 МВт были инжестированы в FRC 450 для длительности импульсов активных пучков в примерно 6 мс. Диамагнитное время жизни плазмы, изображенное на графике А, составляло примерно 5,2 мс. Более поздние данные показывают, что диамагнитное время жизни плазмы примерно 7,2 мс достижимо с длительностью импульсов активных пучков примерно 7 мс.

Как отмечалось выше в связи с фиг. 16А, В, С и D, корреляция между длиной импульсов пучков и временем жизни FRC не является совершенной, поскольку захват пучков становится неэффективным ниже определенного размера плазмы, т.е. по мере того, как FRC 450 сжимается в физическом размере, не все инжестированные пучки перехватываются и захватываются. Сокращение или спад FRC происходит главным образом ввиду того факта, что чистые потери энергии (-4 МВт примерно на полпути через разряд) из плазмы FRC во время разряда несколько превышают общую мощность, подаваемую в FRC через нейтральные пучки (-2,5 МВт) для конкретного экспериментального запуска. Как отмечено в отношении фиг. 3В, наклонная инжестия пучков из пушек 600 нейтральных пучков к средней плоскости улучшает связь пучков с плазмой, даже когда плазма FRC сжимается или иным образом аксиально сужается во время периода инжестии. Кроме того, надлежащая подпитка таблетками будет поддерживать необходимую плотность плазмы.

График В является результатом моделирования, выполненных с использованием длительности импульсов активных пучков примерно 6 мс и общей мощности пучков из пушек 600 нейтральных пучков чуть более примерно 10 МВт, при этом нейтральные пучки должны инжестировать нейтралы Н (или D) с энергией частиц примерно 15 кэВ. Эквивалентный ток, инжеструемый каждым из пучков, составляет примерно 110 А. Для графика В угол инжестии пучков к оси устройства составлял примерно 20°, а целевой радиус - 0,19 м. Угол инжестии может быть изменен в пределах 15-25°. Пучки должны инжестироваться в параллельном направлении азимутально. Чистая боковая сила, а также чистая осевая сила от инжестии импульсов нейтральных пучков должны быть минимизированы. Как и в случае графика А, быстрые (Н) нейтралы инжеструются из инжесторов 600 нейтральных пучков с момента, когда северная и южная формирующие FRC сливаются в камере 100 удержания в одну FRC 450.

Моделирование, при которых основа для графика В использует многомерные холловские МГД-решатели для фоновой плазмы и равновесия, полностью кинетические решатели на основе метода Монте-Карло для энергетических компонентов пучков и всех процессов рассеяния, а также множество связанных уравнений переноса для всех видов плазмы для моделирования процессов интерактивных потерь. Компоненты переноса эмпирически откалиброваны и тщательно сравниваются с экспериментальной базой данных.

Как показано на графике В, диамагнитное время жизни установившегося состояния FRC 450 будет длительностью импульса пучков. Однако важно отметить, что ключевой корреляционный график В показывает, что когда пучки выключены, плазма или FRC начинает спадать в это время, но не раньше. Спад будет аналогичным тому, который наблюдается в разрядах, которые не ассистируются пучками - вероятно, на порядок 1 мс после времени выключения пучков - и просто является отражением характерного времени затухания плазмы, вызванного процессами собственных потерь.

Обращаясь к фиг. 21В, С, D и Е, отмечаем, что результаты экспериментов, проиллюстрированные на этих чертежах, показывают поддержание FRC или установившееся состояние, возбуждаемое от наклонных нейтральных пучков, т.е. глобальные параметры плазмы, такие, как радиус плазмы, плотность плазмы, температура плазмы, а также магнитный поток, поддерживаются на постоянных уровнях без спада в корреляции с длительностью импульсов нейтральных пучков (НП). Например, такие параметры плазмы поддерживаются, по существу, постоянными в течение ~5+ мс. Такие рабочие характеристики плазмы, включая признак поддержания, имеют сильную корреляцию с длительностью импульсов НП, при этом диамагнетизм сохраняется даже в течение нескольких миллисекунд после окончания НП благодаря накапливаемым быстрым ионам. Как изображено, рабочие характеристики плазмы, ограничиваются лишь теми ограничениями по длительности импульсов, возникающими из-за конечных аккумулированных энергий в связанных с этим источниках питания многих критических систем, таких, как инжесторы НП, а также в других компонентах систем.

Вакуумные насосы с захватом многомасштабного типа

Как отмечалось выше в связи с фиг. 3А, В, С, D, Е и 8, в системе 10 FRC развертывают нейтральные пучки 600 атомов, чтобы обеспечить нагрев и возбуждение тока, а также развить давление быстрых частиц. Вокруг центральной камеры 100 удержания расположены отдельные тракты пучков, содержащие

системы 600 инъекции нейтральных пучков атомов и - как показано на фиг. 3С, D, E -предпочтительно наклоненные для инъекции нейтральных частиц к средней плоскости камеры 100 удержания. Чтобы нарастить температуры плазмы и повысить энергии системы, предлагаемая система 10 FRC включает в себя систему 600 инжекторов нейтральных пучков (GYX) повышенной мощности и увеличенной длительности импульсов, например (эти данные приводятся лишь как возможные) -мощности около 20+ МВт при длительности импульсов вплоть до 30 мс.

Чтобы дополнительно улучшить поддержание FRC и продемонстрировать разгон FRC до высоких температур плазмы и повышенных энергий системы, предлагаемая система FRC 10 включает в себя также вакуумные насосы с захватом многомасштабного типа во внутренних и внешних диверторах 300 и 302, чтобы предотвратить накопление нейтрализованного газа в диверторах 300 и 302. Как изображено на фиг. 25, посредством различных механизмов происходят потери заряженных частиц плазмы (например, таких, как азот и дейтерий), что обозначено стрелками А, из внутренней части или активной зоны 453 плазмы 450 FRC в плазму незамкнутых силовых линий. Отсюда, как обозначено стрелками В, заряженные частицы вытекают вдоль незамкнутых силовых линий 452 магнитного поля из центральной емкости 100 для удержания в каждый из диверторов 300 и 302 на любой стороне емкости 100 для удержания.

Оказавшись в диверторах 300 и 302, заряженные частицы будут ударяться о поверхности внутри камер 310 диверторов, например, такие, как поверхности смещающих электродов 910 в диверторах 300 и 302 (фиг. 3А, D, 10 и 26), становясь нейтрализованными и воспринимаются как нейтрализованный газ. Сохранение плотности такого нейтрализованного газа достаточно низкой необходимо для поддержания FRC и разгона до высоких температур плазмы и повышенных энергий систем, потому что электроны в плазме вдоль незамкнутых силовых линий 452 будут ионизировать нейтральный газ в диверторах 300 и 302 и поэтому утрачивать энергию (охлаждаться) в процессе. Электроны, являющиеся слишком холодными, вызывают избыточное торможение и замедляют ионы высокой энергии, движущиеся по орбитам вокруг активной зоны плазмы 450 FRC. Когда плотность нейтрального газа оказывается ниже некоторой заранее заданной, охлаждение электронов из-за ионизации имеет тенденцию быть незначительным.

Во избежание накопления такого нейтрализованного газа в диверторах 300 и 302, нейтрализованный газ надо откачать, чтобы предотвратить превышение заранее определенного максимального уровня Y уровнем N плотности газа, т.е. $N < Y \text{ м}^{-3}$. Например, в некоторых вариантах осуществления это накопление газа не может превышать уровень N плотности, составляющий 10^{18} м^{-3} (эквивалент давления 3×10^{-5} торр при 300 К) во внутренних диверторах 302, и $2 \times 10^{18} \text{ м}^{-3}$ (эквивалент давления 6×10^{-5} торр при 300 К) во внешних диверторах 300. Уровень откачки, необходимый, чтобы предотвратить превышение этого минимального предела плотности/давления, определяется скоростью заряженных частиц, текущих в каждый из четырех диверторов 300 и 302. Необходимый уровень откачки аналогичен переливанию воды в "дырявое ведро", имеющее одну или более дырок. Чем быстрее льют воду в ведро, тем выше уровень, до которого поднимается уровень воды. А чем больше утечка, т.е. чем больше размер и/или количество дыр, тем ниже уровень, до которого падает уровень воды. При достаточно большой утечке (т.е. откачке) уровень воды (т.е. плотность частиц или давление) можно поддерживать ниже предела уровня воды (т.е. заранее определенного предела плотности частиц или давления, например - около 10^{18} м^{-3}), когда воду льют в ведро (т.е. заряженные частицы текут в диверторы 300 и 302).

При эксплуатации настоящей системы 10 FRC, как показано на фиг. 27, ожидается, что все заряженные частицы плазмы, текущие к диверторам 300 и 302, сначала текут в оба внешних дивертора 300 с максимальным расходом примерно $1,25 \times 10^{22}$ шт/с, который в более знакомых единицах вакуума составляет примерно 400 торр-л/с. Варианты осуществления настоящей системы 10 FRC выполнены с возможностью изменения магнитных полей сразу после формирования FRC, например, в пределах примерно 5 миллисекунд, с переключением 75 % общего потока частиц с внешних диверторов 300 на внутренние диверторы 302. Например, начальный расход во внутренние диверторы 302 составит примерно 300 торр-л/с. В пределах некоторого короткого времени, например, около 5-10 миллисекунд после переключения потока частиц с внешних диверторов 300 на внутренние диверторы 302, удержание плазмы в FRC 450 улучшится настолько, что ожидаемые расходы продемонстрируют тенденцию к 4-5-кратному падению, например, до около 60 торр-л/с. Простая имитационная модель нулевого размера показала, что, для поддержания плотности газообразного водорода ниже предпочтительных максимальных пределов, в каждом из четырех диверторов 300 и 302 потребовалась комбинация вакуумного насоса с расходом 2 млн л/с плюс 15 м^3 объемной откачки (позволяющей газу расширяться в пустом объеме). Дейтерий требует параметра откачки, составляющего 1,5 млн л/с.

Чтобы справиться с нагрузками от этих частиц, одновременно сохраняя плотность газа достаточно низкой, требуется огромный объем откачки. Обычные решения, связанные с откачкой, не в состоянии обеспечить необходимый объем откачки в пределах ограничений, связанных с диверторами 300 и 302 предлагаемой системы 10 FRC, включая, например, но не в ограничительном смысле, стоимость, а также ограниченное трехмерное пространство (например, около 15 м^3) и площадь поверхности (например, около 10 м^2) внутри каждого дивертора 300 и 302.

Самый дешевый способ откачки частиц, например, таких, как частицы водорода и дейтерия, заклю-

чается в использовании пленок титана, осажденных на поверхности камер 310 диверторов 300 и 302, чтобы вызвать "прилипание" частиц к поверхностям камер 310 в вакуумном насосе с захватывающего типа (подробнее обсуждаемом ниже). При комнатной температуре достигим параметр откачки примерно $2,2 \text{ л/см}^2\cdot\text{с}$, что соответствует составляющей 5 % вероятности "прилипания" и захвата частиц водорода пленкой. Это называют коэффициентом прилипания, который может находиться в диапазоне от 0 до 100%. Использование ограниченной площади поверхности, величина которой составляет примерно 10 м^2 всей площади, даст общую скорость откачки лишь 22000 л/с при этом коэффициенте прилипания. Эта скорость откачки примерно в 100 раз меньше, чем требуемая для того, чтобы справиться с нагрузкой от частиц, характерной для настоящей системы 10 FRC, при сохранении плотности газа ниже заранее определенного максимума.

Чтобы удовлетворить потребности откачки для настоящей системы 10 FRC, применяется комбинация двух решений, связанных с откачкой. Во-первых, осаждают пленку титана на криогенно охлажденные поверхности, например поверхности, которые криогенно охлаждены примерно до 77 К. Такое охлаждение демонстрирует тенденцию к увеличению вплоть до примерно 4-кратного коэффициента прилипания, скажем, от примерно 5% до примерно 20%. Во вторых, поверхностям откачки придают конфигурацию множества многомасштабных самоподобных поверхностей для дальнейшего увеличения коэффициента прилипания до примерно 3-4-х кратного, скажем, от примерно 20% до примерно 70%. При таких увеличениях коэффициента прилипания достигается 100-кратное увеличение скорости откачки. Например, для водорода достигается скорость откачки 2400000 л/с , а для дейтерия - скорость откачки 1500000 л/с с помощью всего $7,3 \text{ м}^2$ доступной площади поверхности, которая находится внутри вакуумного сосуда объемом 15 м^3 диверторов 300 и 302. Эти насосы в состоянии (имеют производительность, позволяющую) справиться с общим объемом газа, генерируемого в результате одного выстрела плазмой в предлагаемой системе 10 FRC. Насос сохраняет 95% своей скорости откачки из этого объема газа, и эту величину можно восстановить до 100%, осаждая больше титана.

Вакуумный насос захватывающего типа

Захват молекул газа возможен на поверхности плоской плиты 312 (фиг. 28) за счет прилипания к поверхности плиты 312. Захват молекул газа может происходить посредством различных физических процессов, таких, как конденсация, а также физическая или химическая адсорбция на поверхностях, которые могут состоять из материалов многих разных типов. Каждый раз, когда молекула газа ударяется об эту поверхность, ее захват может происходить с вероятностью прилипания между 0 и 100 %. Эта вероятность прилипания на плоской поверхности из-за одного удара в поверхность называется коэффициентом прилипания (КП). Если молекула газа не прилипает, она в типичном случае покинет эту поверхность в произвольном направлении, соответствующем закону косинусов. Коэффициент прилипания к плоской поверхности независим от размеров этой плоской поверхности. Вместе с тем, общая скорость откачки насосом зависит от площади поверхности, коэффициента прилипания (КП) и средней скорости молекул газа и задается формулой (1):

$$\text{скорость} = 0,25(v)\text{КП} \times \text{площадь} \quad (1)$$

Эффективный коэффициент прилипания, а значит и скорость откачки можно увеличить, объединяя две или более поверхностей друг с другом так, что поверхности будут смотреть друг на друга. Например, как показано на фиг. 28, пять плоских стенок 322, 324, 326, 328 и 325 квадратной формы можно объединить, создавая пять сторон куба 320 с одной открытой стороной, так что внутренние поверхности стенок 322, 324, 326, 328 и 325 будут смотреть друг на друга. Молекула газа, попадающая в этот куб 320 на открытой стороне, ударится об одну из упомянутых пяти поверхностей и прилипнет с вероятностью КП. Если молекула газа не прилипает к поверхности, о которую изначально ударяется, молекула газа может направиться наружу с открытой стороны куба 320, куда молекула газа только что попала, или молекула газа может удариться об одну из других четырех поверхностей куба 320, "вид на которую имеет упомянутая поверхность", получая еще один шанс прилипания к поверхности с вероятностью, равной КП. Молекула газа может "подпрыгивать", ударяясь о поверхность куба 320 много раз перед тем, как либо прилипнет к одной из поверхностей, либо вылетит через открытую сторону куба 320. Это эффективно увеличивает вероятность прилипания молекулы газа к поверхности в кубе 320 по сравнению с плоской квадратной поверхностью 312 тех же размеров, что и проем куба 320. Куб 320, в сущности, приравнивается к плоской поверхности 312, но имеет более высокий эффективный КП, чем плоская поверхность 312, если плоская поверхность имеет такую же площадь как открытая сторона куба 320.

При объединении двух или более поверхностей друг с другом таким образом, что поверхности смотрят друг на друга, результирующая форма не обязательно будет формой куба. Результирующая форма может быть любой формой, имеющей несколько поверхностей, которые образуют нечто большее, чем просто плоскую поверхность, такую, как у камеры, полости или канала с открытой стороной. Например, как показано на фиг. 29, можно сформировать коробку с квадратным проемом, подобную кубу 320, показанному на фиг. 28, но с изменяемой глубиной. На фиг. 29 представлен график эффективного КП для квадратного проема коробки в зависимости от отношения глубины к ширине коробки при некотором заданном КП для плоских поверхностей, из которых состоит коробка. Коробка с нулевой глубиной

(в этом случае отношение глубины к ширине тоже равно 0) представляет собой как раз плоскую поверхность 312, так что эффективный КП будет таким же, как заданный КП плоских поверхностей коробки. Показано, что выборочные КП для плоской поверхности включают в себя значения 0,05, 0,10, 0,20 и 0,50. Для отношения глубины к ширине, равного 1, коробка 320(1) представляет собой куб. Коробки 320(2), 320(3), 320(4) и 320(5) имеют отношения глубины к ширине, составляющие 2:1, 3:1, 4:1 и 5:1 соответственно.

Помимо являющегося изменяемым отношения глубины к ширине можно изменять форму и количество открытых сторон. Открытые стороны не обязательно должны быть квадратными, а могут иметь любую форму, включая, но не в ограничительном смысле, шестиугольную, круглую, прямоугольную, треугольную, форму звезды, и т.д., при условии, что две или более внутренних поверхностей смотрят друг на друга. Форма также не обязательно должна состоять из некоторого числа дискретных плоских поверхностей. Это может быть непрерывно криволинейная поверхность, подобная полусфере. Чтобы вычислить эффективный КП для полусферы, предполагают, что криволинейная поверхность состоит из бесконечного количества бесконечно малых плоских поверхностей.

Захватывающие насосы, имеющие самоподобные поверхности

Насос может принимать базовую форму для построения самоподобных структур на многих уровнях масштабов, что резко увеличит эффективный КП. Например, отдельный объект - насос в виде пятистороннего куба 320, описанного выше (фиг. 28 и 29), может быть собран с множеством кубов 320 в матрице 10×10 кубов для образования панели или стенки 330. Состоящую из матрицы кубов панель 330 можно затем использовать для формирования пяти (5) стенок 342, 344, 345, 346 и 348 большего пятистороннего (5-стороннего) куба 340.

Этот процесс можно повторять снова и снова, увеличивая КП, а значит и скорость и производительность откачки. Например, как изображено на фиг. 31 и 32, если для формирования пятистороннего куба 320 используют плоскую квадратную плиту 312, имеющую КП 5 %, то КП куба 320 с открытой стороной увеличится до 20 %. Потом можно собрать куб 320 с множеством кубов 320 в матрице кубов 10×10 , чтобы сформировать "гладкую" квадратную плоскость или стенку 330 с КП, равным 20 %. Если для формирования пятистороннего куба 340 со сторонами 342, 344, 345, 346 и 348 используют стенку 330 матрицы кубов, имеющую КП 20 %, КП куба 340 с открытой стороной увеличится до 50 %. Затем куб 340 можно собрать с множеством кубов 340 в матрице кубов 10×10 , чтобы сформировать "гладкую" квадратную плоскость или стенку 360 с КП, равным 50 %. Если для формирования пятистороннего куба 380 со сторонами 382, 384, 385, 386 и 388 используют стенку 360 матрицы, имеющую КП 50 %, КП куба 380 с открытой стороной увеличится до 80 %. При желании, этот процесс можно повторять до достижения некоторого оптимального уровня КП.

Как показано на фиг. 26, во внутренней части камеры 310 диверторов 300 и 302 расположено множество коробок 380 большего размера.

КП не зависит от размеров. Увеличение КП, связанное с кубами согласно предыдущему примеру, может быть достигнуто посредством кубов с проемом таких же размеров, а не за счет увеличения проема. Иными словами, переходя от конфигурации первого куба 320 к конфигурации третьего куба 380 и сохраняя при этом проемы первого и третьего кубов 320 и 380 имеющими такие же размеры, достигают четырехкратного увеличения КП, а значит и скорости откачки, по отношению к КП плоской плиты, соответствующей площади проема. Это пример дискретных уровней масштабов согласно самоподобию. Первый куб 320 представляет собой лишь одномасштабный куб, т.е. внутренние поверхности стенок куба 320 содержат плоские поверхности. Вместе с тем, внутренние поверхности стенок второго куба 340 являются не плоскими, а скорее включающими в себя матрицу первых кубов 320. Аналогично внутренние поверхности третьего куба 380 включают в себя матрицу вторых кубов 340.

Что касается увеличения КП, скорости и производительности откачки, то не выдвигается требование, согласно которому объекты - отдельные насосы, используемые для преобразования плоской поверхности в трехмерную (3-мерную) поверхность, должны иметь такие же формы или размеры. Объекты - отдельные насосы как раз должны иметь форму, которая способствует увеличению КП по отношению к плоской плите, соответствующей проему объектов - отдельных насосов. В примерах, приведенных выше, в размерах масштабов самоподобных кубов использовалось отношение 10:1, но это отношение может быть любым. Количество уровней масштабов, форму и размеры можно оптимизировать по ситуации.

Как упоминалось выше, для достижения коэффициента прилипания 80% или выше, в предлагаемой системе 10 FRC используется сочетание криогенно охлаждаемых поверхностей и самоподобных форм. В некоторых ситуациях КП уменьшаются вплоть до 70% в результате наличия нескольких экранов, которые предотвращают осаждение титана через проемы отдельных насосов.

Существуют способы естественного получения самоподобных структур этих типов. Пленки титана, выращенные на криогенно охлажденной поверхности под разными давлениями серебра, дадут субмикронные структуры, которые демонстрируют самоподобие, и увеличат коэффициент прилипания поверхности. Вместе с тем, самоподобные структуры, например, такие как кубы 320, 340 и 380, представляют собой специально спроектированные самоподобные структуры, которые не выращены из осажденных пленок, но могут быть использованы в сочетании с осажденными пленками.

Помимо применения титановых покрытий существуют многие другие способы, которыми можно захватывать газ на поверхностях. Два из наиболее распространенных предусматривают применение нераспыляемых газопоглотителей (геттеров) (НРГ) и криогенно охлажденного активированного древесного угля.

Во всех ускорителях частиц обычно используют насосы на не распыляемых газопоглотителях (НРГ). Их изготавливают из смесей порошков титана, ванадия, алюминия, циркония и железа.

В типичных случаях этот порошок НРГ спекают в диски, которые представляют собой скомпонованные разнесенные стопки, или на металлическую нагревательную ленту, которую затем гнут в формы. Поэтому применяются формы лент, увеличивающие коэффициент прилипания, но лишь на одном уровне масштаба. Им не придают формы самоподобных структур на многомасштабных габаритах. Эти порошки НРГ можно спекать в структуры самоподобных форм, чтобы увеличить их малые коэффициенты прилипания и, тем самым, скорость откачки без увеличения размеров насоса. Увеличенная скорость откачки НРГ способствовала бы повышению рабочих характеристик вакуума ускорителей частиц.

Активированный древесный уголь, охлажденный до 10 К, может захватывать газообразный водород, а дополнительно охлажденный до 4 К может захватывать газообразный гелий. Это один из немногих способов откачки газообразного гелия. Он используется как средство откачки в термоядерных устройствах, таких, как токамаки и ускорители пучков нейтральных частиц. Прилипание к порошкообразному активированному древесному углю на самоподобную структуру будет увеличивать коэффициент прилипания и скорости откачки.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предложен способ генерирования и поддержания магнитного поля с конфигурацией с обращенным полем (FRC), содержащий формирование FRC вокруг плазмы в камере удержания, инъекцию множества пучков нейтральных частиц в плазму FRC под некоторым углом к средней плоскости камеры удержания, откачку молекул нейтрального газа, аккумулируемых в первых и вторых диаметрально противоположных диверторах, связанных с камерой удержания, посредством первых и вторых захватывающих вакуумных насосов, расположенных в первых и вторых диверторах и содержащих две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, более чем в четыре (4) раза превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из упомянутых двух или более сторон первых и вторых захватывающих вакуумных насосов содержит матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из упомянутых двух или более сторон каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит вторую матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, в N раз превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов, причем N удовлетворяет неравенству $4 < N < 16$.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения поверхности плоской плиты и первых и вторых вакуумных насосов включают в себя осажденную на них пленку титана.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно включает в себя поддержание FRC при постоянном значении или около него без спада путем инъекции пучков быстрых нейтральных атомов из инжекторов пучков нейтральных частиц в плазму FRC под углом к средней секущей плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование магнитного поля в пределах камеры удержания с помощью катушек квазипостоянного тока, простирающихся вокруг камеры удержания, и зеркального магнитного поля в пределах противоположных торцов камеры удержания с помощью зеркальных катушек квазипостоян-

ного тока, простирающихся вокруг противоположных торцов камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование магнитного поля в пределах камеры удержания с помощью катушек квазипостоянного тока, простирающихся вокруг камеры удержания, и зеркального магнитного поля в пределах противоположных торцов камеры удержания с помощью зеркальных катушек квазипостоянного тока, простирающихся вокруг противоположных торцов камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения формирование FRC включает в себя формирование формирующей FRC в противоположных первой и второй формирующих секциях, связанных с камерой удержания, и ускорение формирующей FRC из первой и второй формирующих секций к средней секущей плоскости камеры удержания, где обе формируемые FRC объединяются, образуя одну FRC.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения формирование FRC включает в себя одно из формирования формирующей FRC при ускорении формирующей FRC к средней секущей плоскости камеры удержания и формирования формирующей FRC с последующим ускорением формирующей FRC к средней секущей плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения ускорение формирующей FRC из первой и второй формирующих секций к средней секущей плоскости камеры удержания включает в себя пропускание формирующей FRC из первой и второй формирующих секций через первый и второй внутренние диверторы, связанные с противоположными торцами камеры удержания, находящиеся между камерой удержания и первой и второй формирующими секциями.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения пропускание формирующей FRC из первой и второй формирующих секций через первый и второй внутренние диверторы включает в себя деактивацию первого и второго внутренних диверторов, когда формируемая FRC из первой и второй формирующих секций проходит через первый и второй внутренние диверторы.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит направление поверхностей магнитного потока FRC в первый и второй внутренние диверторы.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит направление поверхностей магнитного потока FRC в первый и второй внешние диверторы, связанные с торцами формирующих секций.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование магнитного поля в пределах формирующих секций и первого и второго внешних диверторов с помощью катушек постоянного тока, простирающихся вокруг формирующих секций и диверторов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование магнитного поля в пределах формирующих секций и первого и второго внутренних диверторов с помощью катушек квазипостоянного тока, простирающихся вокруг формирующих секций и диверторов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование зеркального магнитного поля между первой и второй формирующими секциями и первым и вторым внешними диверторами с помощью катушек квазипостоянного тока.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование магнитного поля зеркальных пробок в пределах сужения между первой и второй формирующими секциями и первым и вторым внешними диверторами с помощью зеркальных пробочных катушек квазипостоянного тока, простирающихся вокруг сужения между формирующими секциями и диверторами.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование зеркального магнитного поля между камерой удержания и первым и вторым внутренними диверторами с помощью зеркальных катушек квазипостоянного тока и генерирование сужающегося магнитного поля между первой и второй формирующими секциями и первым и вторым внутренними диверторами с помощью низкопрофильных обжимных катушек постоянного тока.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит генерирование одного из магнитного дипольного поля и магнитного квадрупольного поля в пределах камеры с помощью отклоняющих катушек, связанных с камерой.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит кондиционирование внутренних поверхностей камеры и внутренних поверхностей первой и второй формирующих секций, причем первый и второй диверторы находятся между камерой удержания и первой и второй формирующими секциями, а первый и второй внешние диверторы связаны с первой и второй формирующими секциями с помощью системы геттерирования.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения система геттерирования включает в себя одну из системы осаждения титана и системы осаждения лития.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ допол-

нительно содержит осевую инжекцию плазмы в FRC из аксиально установленных плазменных пушек.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит управление радиальным профилем электрического поля в граничном слое FRC.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения управление радиальным профилем электрического поля в граничном слое FRC включает в себя приложение распределения электрического потенциала к группе незамкнутых поверхностей потока FRC с помощью смещающих электродов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения способ дополнительно содержит инжекцию плазм компактных тороидов (КТ) из первого и второго инжекторов КТ в плазму FRC под углом к средней плоскости камеры удержания, при этом первый и второй инжекторы КТ диаметрально противоположны, находясь с противоположных сторон от средней плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения захватывающий вакуумный насос содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов имеет коэффициент прилипания, превышающий более, чем в четыре (4) раза коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне захватывающего насоса.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из упомянутых двух или более сторон первых и вторых захватывающих вакуумных насосов содержит матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения по меньшей мере одна из упомянутых двух или более сторон каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит вторую матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы содержит две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, в N раз превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов, причем N удовлетворяет неравенству $4 < N < 16$.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения поверхности плоской плиты и первых и вторых вакуумных насосов включает в себя осажденную на них пленку титана.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения предложена система для генерирования и поддержания магнитного поля с конфигурацией с обращенным полем (FRC), содержащая камеру удержания, первую и вторую диаметрально противоположные формирующие FRC секции, связанные с камерой удержания и включающие в себя первые и вторые захватывающие вакуумные насосы, расположенные в первых и вторых диверторах и содержащие две или более сторон с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом первые и вторые захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, более чем в четыре (4) раза превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первых и вторых захватывающих насосов, одну или более из множества плазменных пушек, один или более смещающих электродов и первую и вторую зеркальные пробки, причем упомянутое множество плазменных пушек включает в себя первую и вторую осевые плазменные пушки, функционально связанные с первыми и вторыми диверторами, первой и второй формирующими секциями и камерой удержания, при этом упомянутый один или более смещающих электродов расположены в пределах одной или более из камеры удержания, первой и второй формирующих секций и первого и второго внешних диверторов, и при этом первая и вторая зеркальные пробки расположены между первой и второй формирующими секциями и первыми и вторыми диверторами, систему геттерирования, связанную с камерой удержания и первыми и вторыми диверторами, множество инжекторов нейтральных пучков атомов, связанных с камерой удержания и наклоненных к средней плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения система выполнена с возможностью генерирования FRC и поддержания FRC без спада при инжекции пучков нейтральных частиц в плазму.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения первые и вторые диверторы содержат первый и второй внутренние диверторы, находящиеся между первой и второй формирующими секциями и камерой удержания, и дополнительно содержат первый и второй внешние диверторы, связанные с первой и второй формирующими секциями, причем первая и вторая формирующие секции находятся между первым и вторым внутренними диверторами и первым и вторым внешними диверторами.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения система дополнительно содержит первую и вторую осевые плазменные пушки, функционально связанные с первыми и вторыми внутренними и внешними диверторами, первой и второй формирующими секциями и камерой удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения система дополнительно содержит две или более отклоняющих катушек, связанных с камерой удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения формирующая секция содержит построенные из модулей формирующие системы для генерирования FRC и поступательного перемещения ее к средней плоскости камеры удержания.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения смещающие электроды включают в себя один или более из: одного или более точечных электродов, расположенных в пределах камеры удержания, для контакта с незамкнутыми силовыми линиями; набора кольцевых электродов между камерой удержания и первой и второй формирующими секциями для зарядки дальних граничных слоев по азимутально симметричной схеме; множества электродов, концентрично уложенных в стопу, расположенных в первых и вторых диверторах для зарядки множества концентрических слоев потока; и анодов плазменных пушек для перехвата незамкнутого потока.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения система дополнительно содержит первый и второй инжекторы компактных тороидов (КТ), связанные с камерой удержания, под углом к средней плоскости камеры удержания, при этом первый и второй инжекторы КТ диаметрально противоположны, находясь с противоположных сторон от средней плоскости камеры удержания.

Однако возможные варианты осуществления, представленные здесь, предназначены лишь в качестве иллюстративных примеров и никоим образом не ограничительных.

Все признаки, элементы, компоненты, функции и этапы, описанные в отношении любого варианта осуществления, представленного здесь, предназначены быть свободно комбинируемыми и заменяемыми соответствующими из любого другого варианта осуществления. Если некоторый признак, элемент, компонент, функция или этап описаны в отношении только одного варианта осуществления, то следует понимать, что тот признак, элемент, компонент, функция или этап могут использоваться с любым другим вариантом осуществления, описанным здесь, если явно не указано иное. Этот абзац, таким образом, в любое время служит антецедентной основой и письменной поддержкой для введения формулы изобретения, которая комбинирует признаки, элементы, компоненты, функции и этапы из разных вариантов осуществления или заменяет признаки, элементы, компоненты, функции и этапы из одного варианта осуществления соответствующими из другого, даже если следующее описание явно не указывает, в конкретном случае, что такие комбинации или замены возможны. Явное перечисление каждой возможной комбинации и замены является чрезмерно обременительным, особенно учитывая, что допустимость всякой и каждой такой комбинации и замены будет легко понята специалистами в данной области техники по прочтении этого описания.

Во многих случаях объекты описываются здесь как связанные с другими объектами. Следует понять, что термины "связанный (связанная, связанное, связанные)" и "соединенный (соединенная, соединенное, соединенные)" или любые из их форм употребляются здесь взаимозаменяемо и в обоих случаях являются родовыми для непосредственной связи двух объектов (без каких-либо существенных (например - паразитных) промежуточных объектов) и косвенной связи двух объектов (с одним или несколькими промежуточными объектами). Если объекты показаны как непосредственно связанные воедино или описаны как связанные воедино без описания какого-либо промежуточного объекта, следует понять, что эти объекты тоже могут быть непосредственно связаны воедино, если в контексте явно не диктуется иное.

Хотя варианты осуществления могут быть подвергнуты внесению различных модификаций и альтернативных форм, их конкретные примеры показаны на чертежах и описаны здесь подробно. Однако должно быть ясно, что эти варианты осуществления не ограничиваются раскрытой конкретной формой, а наоборот, эти варианты осуществления следует считать охватывающими все модификации, эквиваленты и альтернативы, находящиеся в рамках существа изобретения. Помимо этого, приводить в формуле изобретения или вносить в нее можно любые признаки, функции, этапы или элементы согласно вариантам осуществления, а также отрицательные ограничения, которые определяют объем притязаний согласно изобретению признаками, функциями, этапами или элементами, находящимися вне этого объема.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Захватывающий вакуумный насос, содержащий камеру (320) с открытой стороной, содержащую две или более плит (322, 324, 326, 328) с поверхностями, смотрящими друг на друга, причем упомянутые две или более плит включают одну или более боковых плит, соединенных с торцевой плитой (312) на первом торце упомянутых одной или более боковых плит и простирающихся к отверстию, ограниченному вторым торцом упомянутых одной или более боковых плит, причем отверстие ограничивает площадь, эквивалентную поверхности торцевой плиты, при длине упомянутых одной или более боковых плит, ограничивающей длину (D) захватывающего вакуумного насоса и упомянутых двух или более плит с поверхностями, смотрящими на отверстие,

осажденную на поверхностях плит пленку титана, причем поверхности с осажденной пленкой титана имеют коэффициент прилипания, соответствующий вероятности прилипания отдельной молекулы газа к поверхности с осажденной пленкой вследствие одного удара отдельной молекулы газа в поверхность с осажденной пленкой, когда поверхности с осажденной пленкой подвергаются воздействию газа, при этом захватывающий вакуумный насос имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания поверхности с осажденной пленкой торцевой плиты самой по себе.

2. Вакуумирующий узел, содержащий первый захватывающий вакуумный насос и второй захватывающий вакуумный насос, причем каждый из первого и второго захватывающих вакуумных насосов является захватывающим вакуумным насосом (320) по п.1.

3. Узел по п.2, причем по меньшей мере одна из упомянутых двух или более плит первого и второго захватывающих вакуумных насосов (340) содержит первую матрицу (330) отдельных захватывающих вакуумных насосов (320), причем каждый отдельный захватывающий вакуумный насос в первой матрице отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит две или более плит (322, 324, 326, 328) с поверхностями, смотрящими друг на друга, причем упомянутые две или более плит включают одну или более боковых плит, соединенных с торцевой плитой (312) на первом торце упомянутых одной или более боковых плит и простирающихся к отверстию, ограниченному вторым торцом упомянутых одной или более боковых плит, причем отверстие ограничивает площадь, эквивалентную поверхности торцевой плиты, при длине упомянутых одной или более боковых плит, ограничивающей длину (D) отдельного захватывающего вакуумного насоса и упомянутых двух или более плит с поверхностями, смотрящими на отверстие.

4. Узел по п.3, причем по меньшей мере одна из упомянутых двух или более плит каждого отдельного захватывающего вакуумного насоса (380) в матрице отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит вторую матрицу (360) отдельных захватывающих вакуумных насосов (340), причем каждый отдельный захватывающий вакуумный насос во второй матрице отдельных захватывающих вакуумных насосов является захватывающим вакуумным насосом, содержащим две или более плит с поверхностями, смотрящими друг на друга, причем упомянутые две или более плит включают одну или более боковых плит, соединенных с торцевой плитой на первом торце упомянутых одной или более боковых плит и простирающихся к отверстию, ограниченному вторым торцом упомянутых одной или более боковых плит, причем отверстие ограничивает площадь, эквивалентную поверхности торцевой плиты, при длине упомянутых одной или более боковых плит, ограничивающей длину (D) отдельного захватывающего вакуумного насоса и упомянутых двух или более плит с поверхностями, смотрящими на отверстие.

5. Узел по любому из пп.2-4, причем первый и второй захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, в N раз превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первого и второго захватывающих насосов, причем N удовлетворяет неравенству $4 < N < 16$.

6. Узел по любому из пп.2-4, причем поверхности с осажденной пленкой торцевой плиты и первых и вторых боковых плит включают в себя осажденную на них пленку титана.

7. Система для генерирования и поддержания магнитного поля с конфигурацией с обращенным полюсом (FRC), содержащая камеру удержания (100);

первую и вторую диаметрально противоположные, формирующие FRC секции (200), расположенные рядом с первым и вторым торцами камеры удержания;

первые и вторые диверторы (300, 302), связанные с первой и второй формирующими секциями, причем первые и вторые диверторы включают в себя узел захватывающих вакуумных насосов, содержащий первый и второй захватывающие вакуумные насосы, расположенный в пределах первых и вторых диверторов и содержащий две или более боковых плит с поверхностями, смотрящими друг на друга, и открытую сторону, при этом первый и второй захватывающие вакуумные насосы (320, 340, 380) имеют коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную открытой стороне первого и второго захватывающих насосов,

причем по меньшей мере одна из упомянутых двух или более плит (322, 324, 326, 328) первого и второго захватывающих вакуумных насосов содержит матрицу (330) отдельных захватывающих вакуум-

ных насосов, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит торцевую плиту, имеющую поверхность, и две или более боковых плит с поверхностями, смотрящими друг на друга, и соединенных с торцевой плитой на первом торце упомянутых двух или более боковых плит и простирающихся к отверстию, ограниченному вторым торцом упомянутых двух или более боковых плит, причем отверстие ограничивает площадь, эквивалентную поверхности торцевой плиты, при этом каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания поверхности плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную отверстию каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов;

одно или более из множества плазменных пушек (350), одного или более смещающих электродов (900, 905, 910, 920) и первой и второй зеркальных пробок (440), причем упомянутое множество плазменных пушек включает в себя первую и вторую осевые плазменные пушки, функционально связанные с первыми и вторыми диверторами, первой и второй формирующими секциями и камерой удержания, при этом упомянутые один или более смещающих электродов расположены в пределах одного или более из камеры удержания, первой и второй формирующих секций и первых и вторых диверторов, и при этом упомянутые первая и вторая зеркальные пробки расположены между первой и второй формирующими секциями и первыми и вторыми диверторами;

систему геттерирования (800), связанную с камерой удержания и первыми и вторыми диверторами; множество инжекторов (600, 615) пучков нейтральных атомов, связанных с камерой удержания и наклоненных к средней плоскости камеры удержания под углом, отклоненным от нормали к продольной оси камеры удержания на $15-25^\circ$; и

магнитную систему (400, 410), содержащую множество катушек (412, 414, 416) квазипостоянного тока, расположенных вокруг камеры удержания, первой и второй формирующих секций и первых и вторых диверторов, и первый и второй наборы зеркальных катушек (420) квазипостоянного тока, расположенных между первой и второй формирующими секциями и первыми и вторыми диверторами.

8. Система по п.7, причем по меньшей мере одна из упомянутых двух или более боковых плит каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов содержит вторую матрицу отдельных захватывающих вакуумных насосов.

9. Система по п.8, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы содержит торцевую плиту, имеющую поверхность, и две или более боковых плит с поверхностями, смотрящими друг на друга, и соединенных с торцевой плитой на первом торце упомянутых двух или более боковых плит и простирающихся к отверстию, ограниченному вторым торцом упомянутых двух или более боковых плит, причем отверстие ограничивает площадь, эквивалентную поверхности торцевой плиты, причем каждый из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы имеет коэффициент прилипания, превышающий коэффициент прилипания поверхности плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную отверстию каждого из отдельных захватывающих вакуумных насосов второй матрицы.

10. Система по п.7, причем первый и второй захватывающие вакуумные насосы имеют коэффициент прилипания, в N раз превышающий коэффициент прилипания поверхности плоской плиты, ограничивающей площадь, эквивалентную отверстию первого и второго захватывающих насосов, причем N удовлетворяет неравенству $4 < N < 16$.

11. Система по п.7, причем поверхности первого и второго вакуумных насосов включают осажденную на них пленку титана.

12. Система по п.7, причем система выполнена с возможностью генерирования плазмы FRC и поддержания плазмы FRC без спада при инъекции пучков нейтральных атомов в плазму.

13. Система по п.7, причем первые и вторые диверторы содержат первый и второй внутренние диверторы, заключенные между первой и второй формирующими секциями и камерой удержания, и дополнительно содержат первый и второй внешние диверторы, связанные с первой и второй формирующими секциями, причем первая и вторая формирующие секции заключены между первым и вторым внутренними диверторами и первым и вторым внешними диверторами.

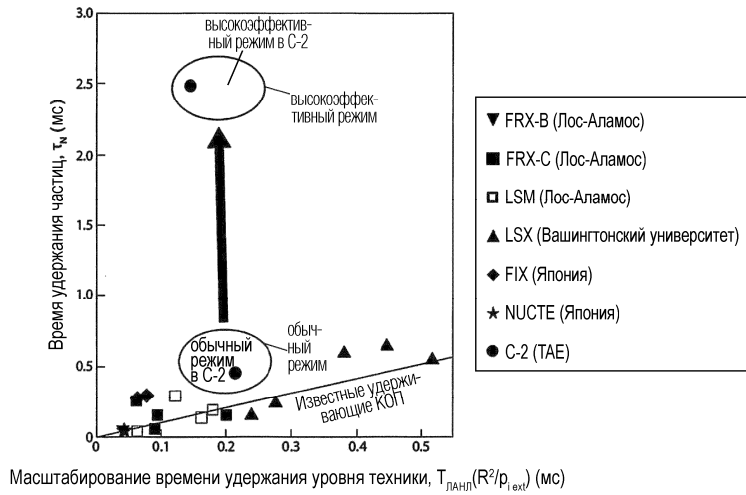
14. Система по п.13, дополнительно содержащая первую и вторую осевые плазменные пушки, функционально связанные с первыми и вторыми внутренними и внешними диверторами, первой и второй формирующими секциями и камерой удержания.

15. Система по п.13, дополнительно содержащая две или более отклоняющих катушек, связанных с камерой удержания.

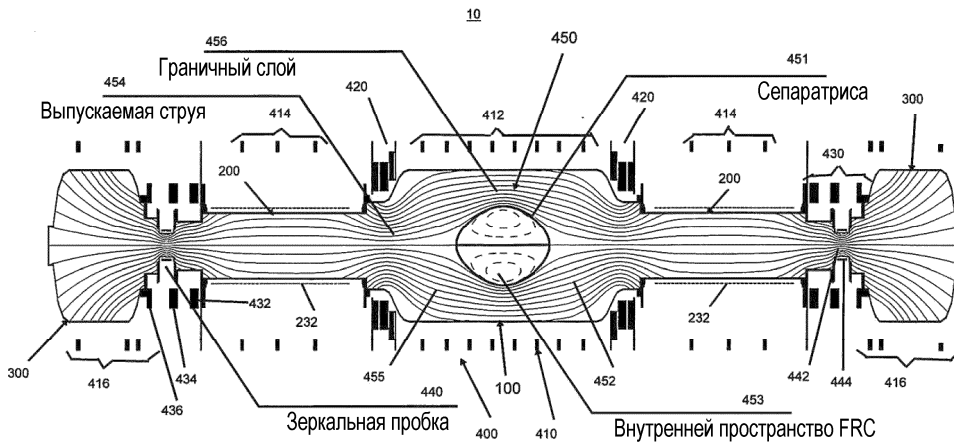
16. Система по п.7, причем формирующая секция содержит построенные из модулей формирующие системы для генерирования FRC и ее поступательного перемещения к средней плоскости камеры удержания.

17. Система по п.7, причем смещающие электроды включают одно или более из: одного или более точечных электродов, расположенных в пределах камеры удержания, для контакта с незамкнутыми силовыми линиями; набора кольцевых электродов между камерой удержания и первой и второй формирующими секциями для зарядки дальнеграничных слоев потока по азимутально симметричной схеме; множества концентрично уложенных электродов, расположенных в первых и вторых диверторах, для

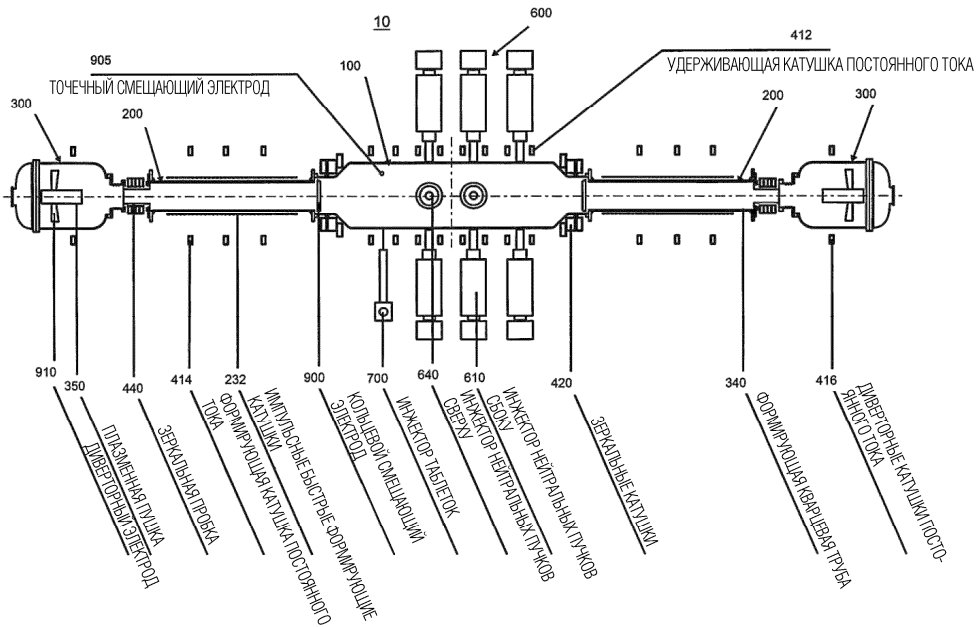
зарядки множества концентрических слоев потока; и анодов плазменных пушек для перехвата незамкнутого потока.



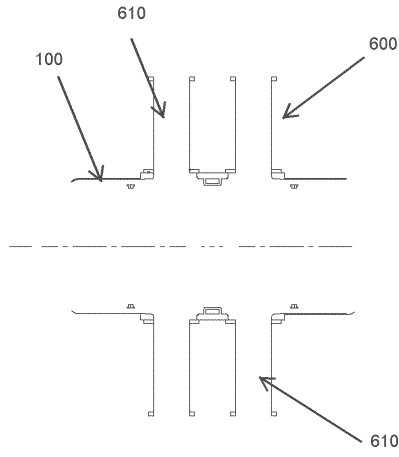
Фиг. 1



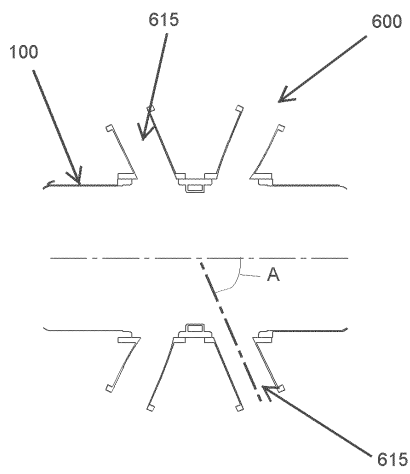
Фиг. 2



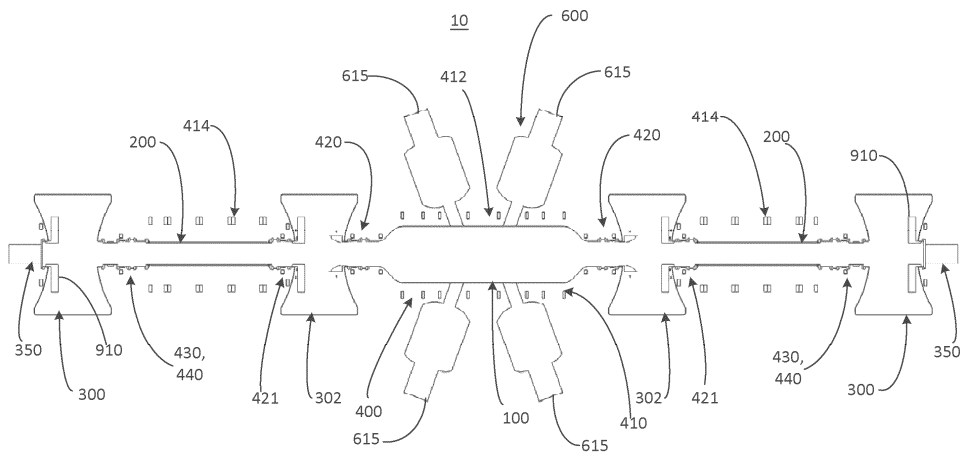
Фиг. 3А



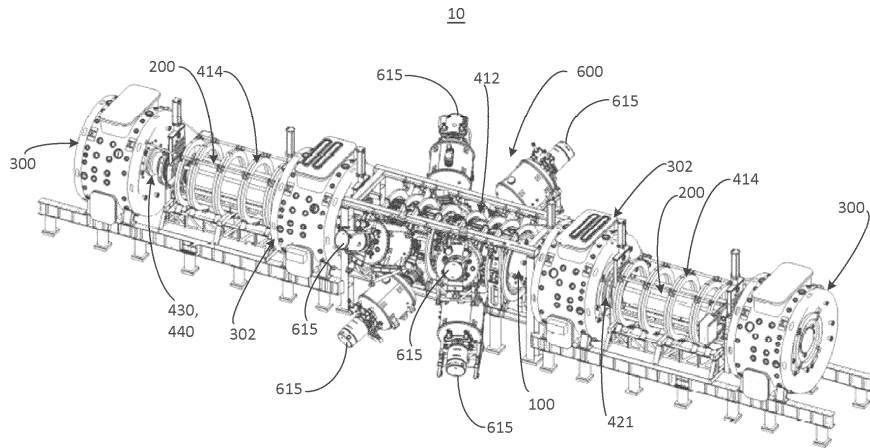
Фиг. 3В



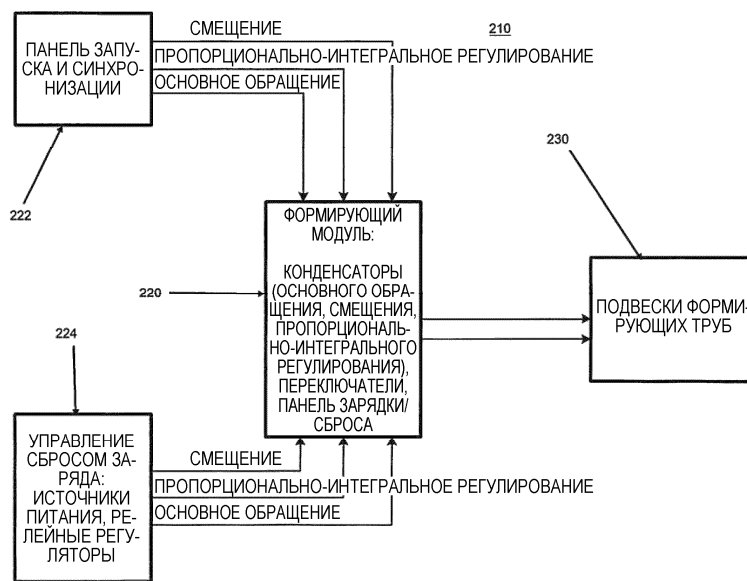
Фиг. 3С



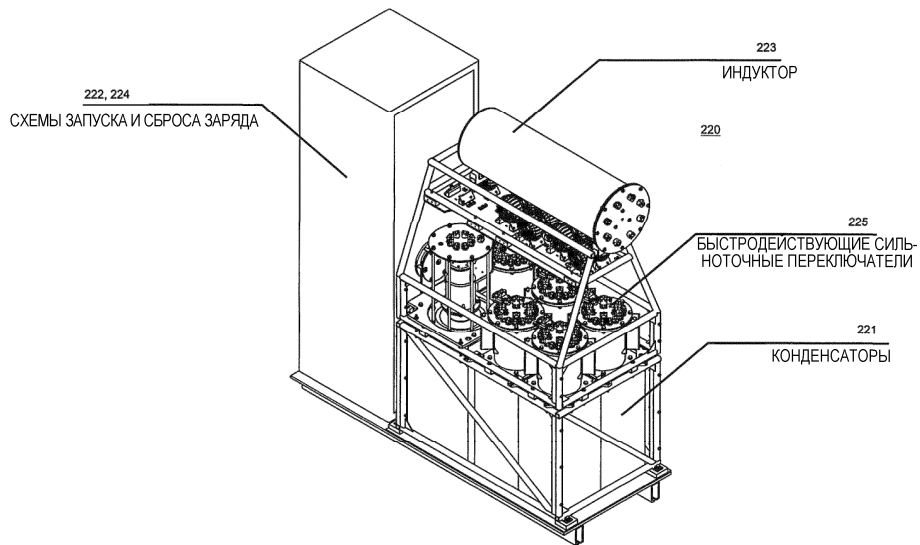
Фиг. 3D



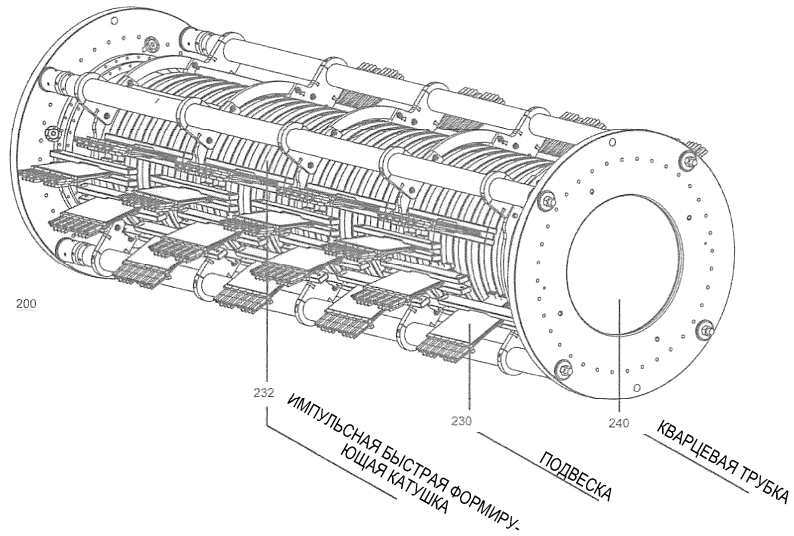
Фиг. 3Е



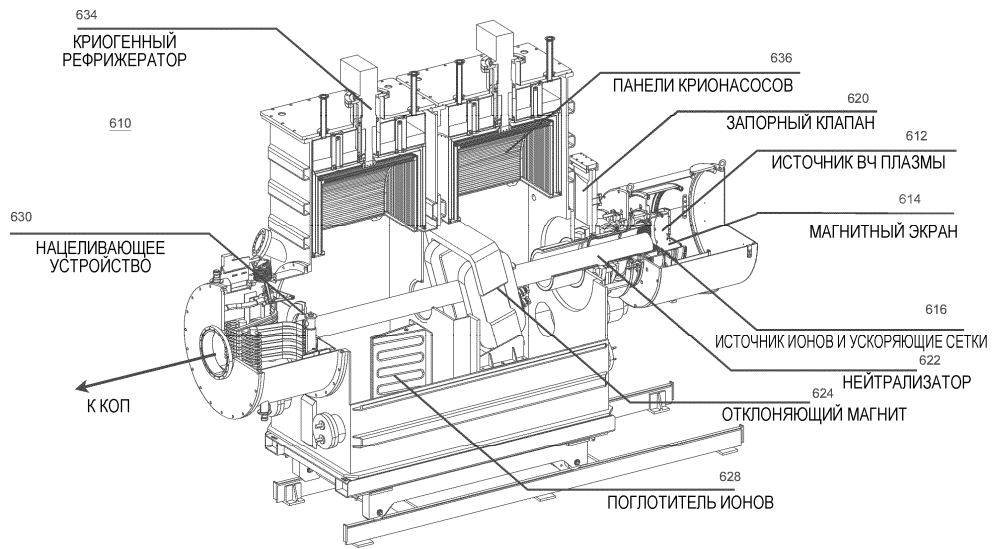
Фиг. 4



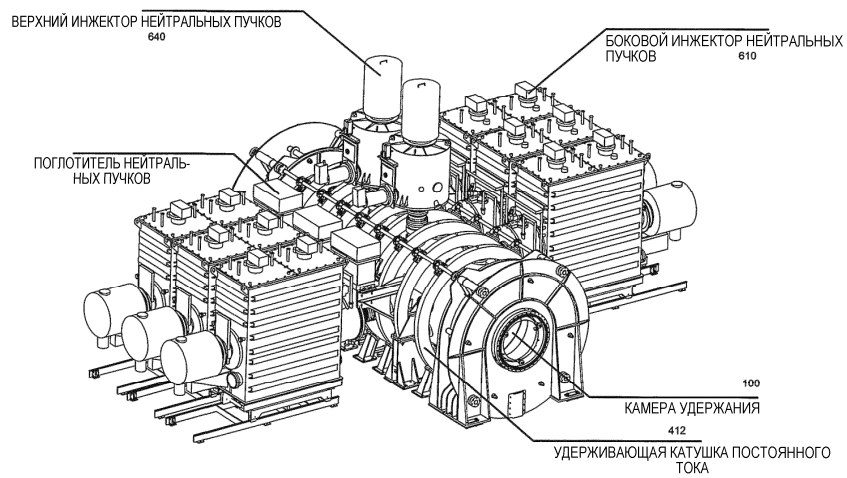
Фиг. 5



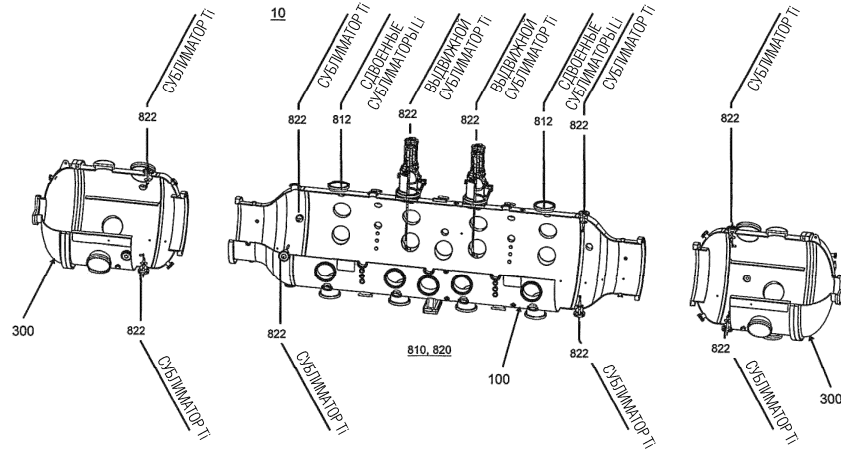
Фиг. 6



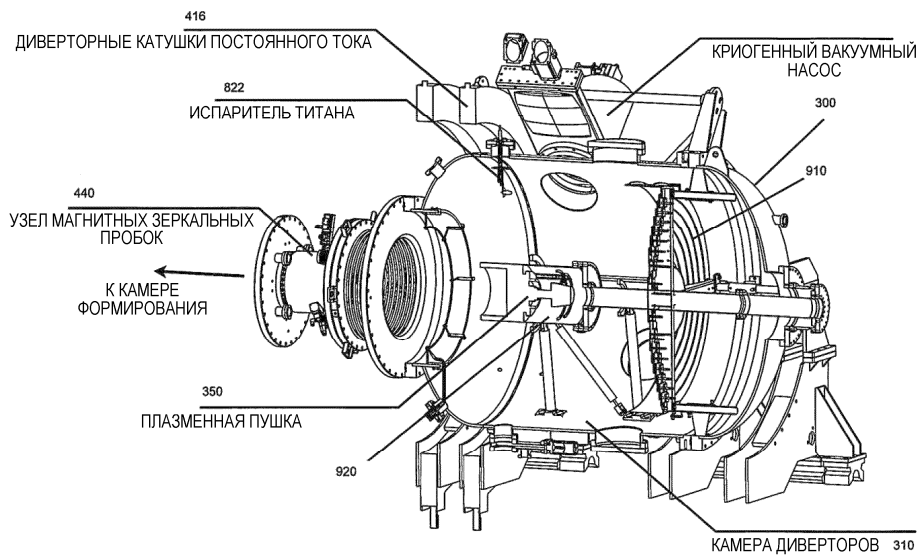
Фиг. 7



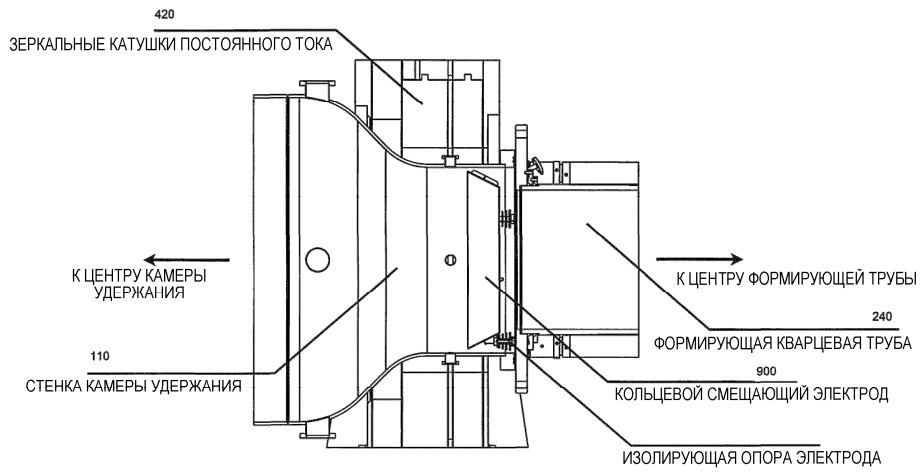
Фиг. 8



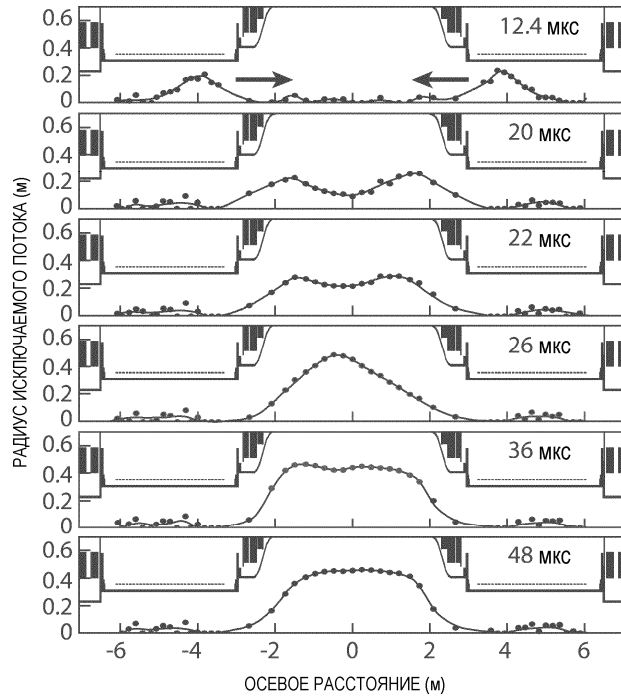
Фиг. 9



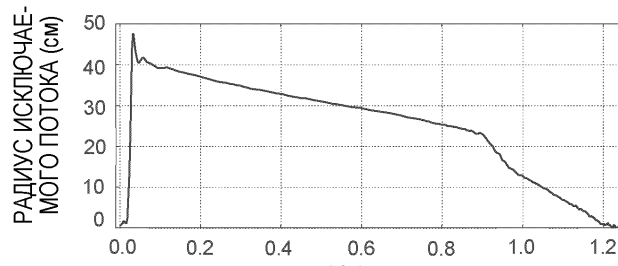
Фиг. 10



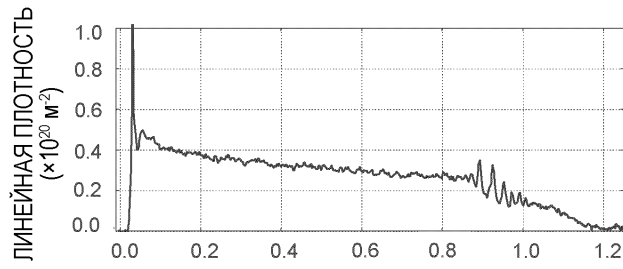
Фиг. 11



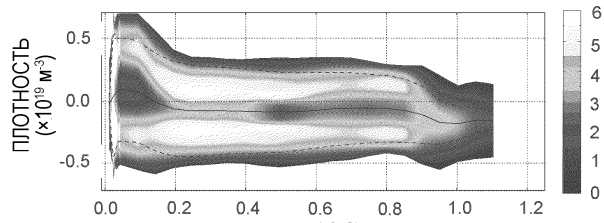
Фиг. 12



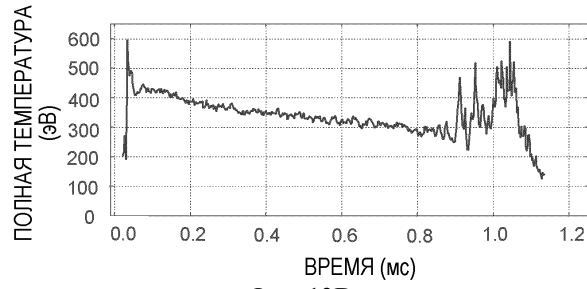
Фиг. 13А



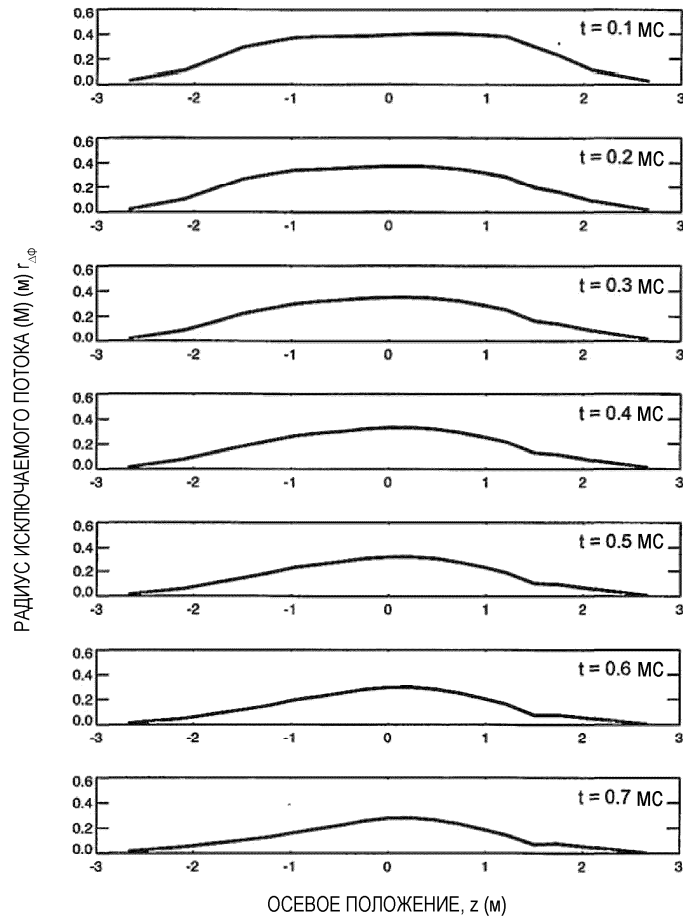
Фиг. 13В



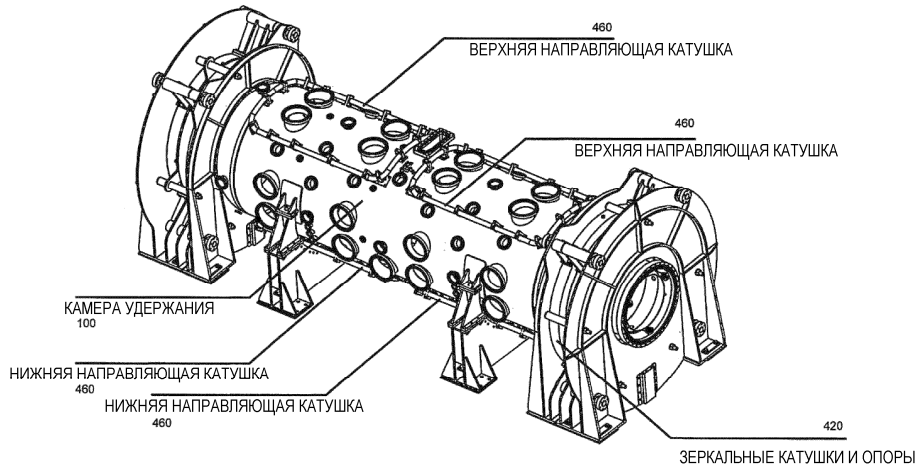
Фиг. 13С



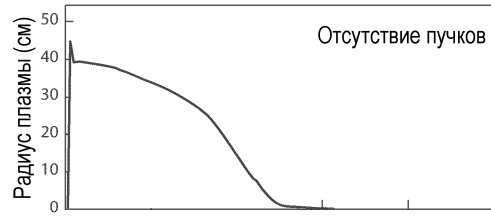
Фиг. 13D



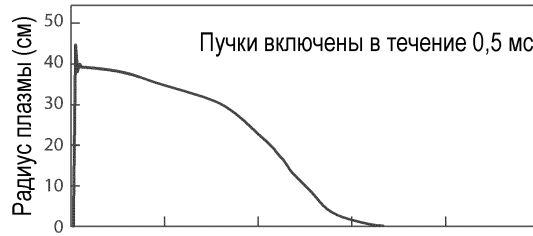
Фиг. 14



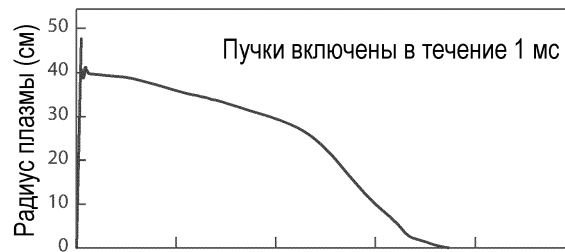
Фиг. 15



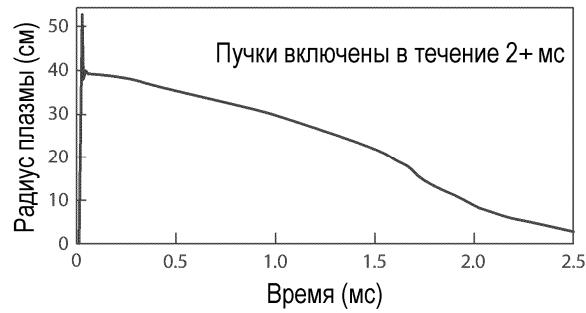
Фиг. 16А



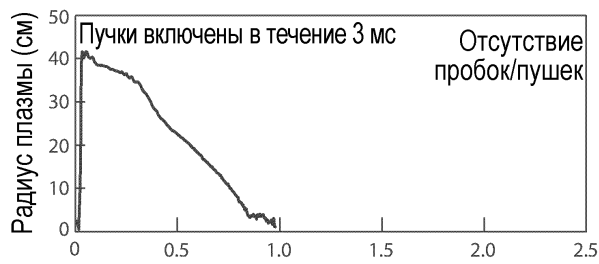
Фиг. 16В



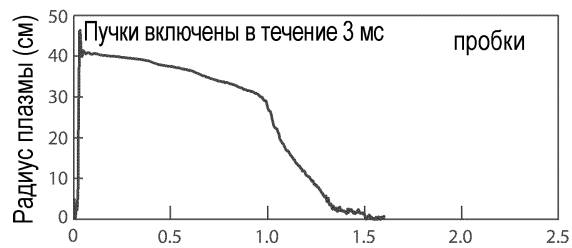
Фиг. 16С



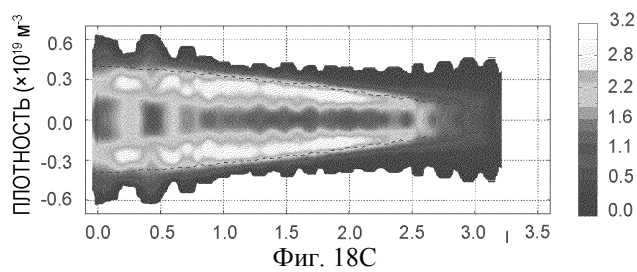
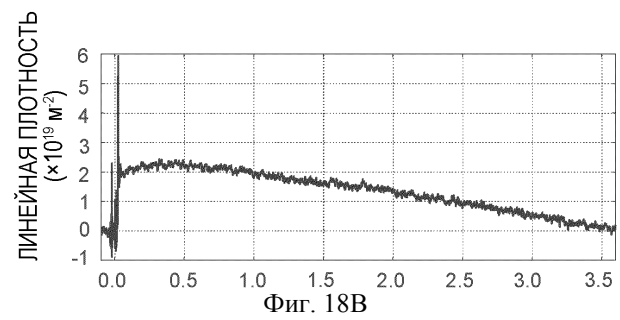
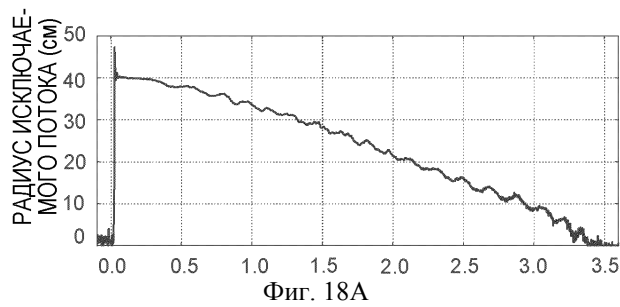
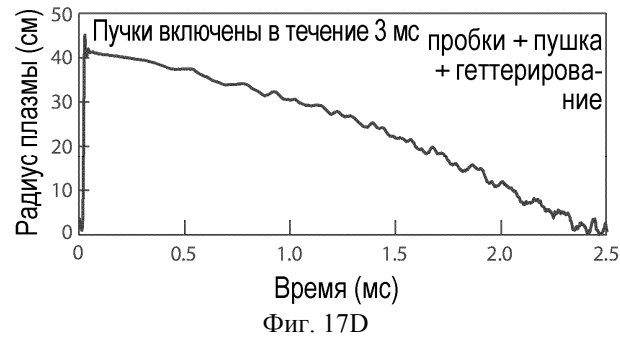
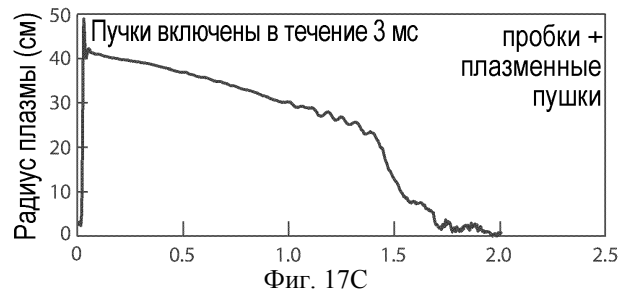
Фиг. 16D

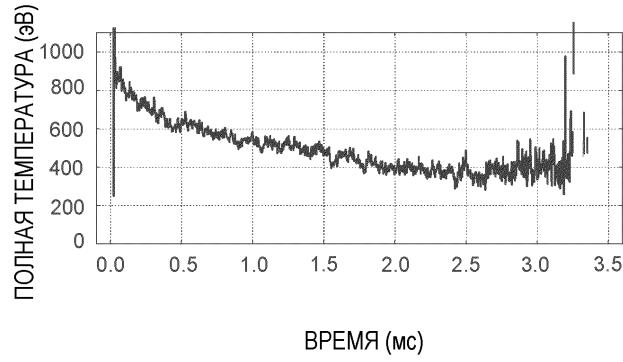


Фиг. 17А

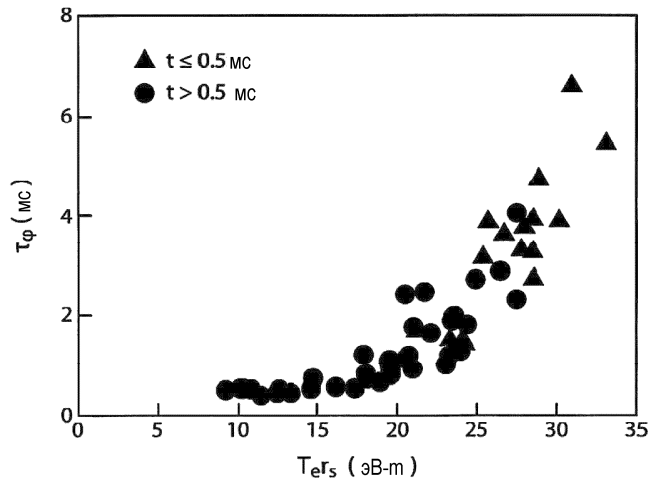


Фиг. 17В

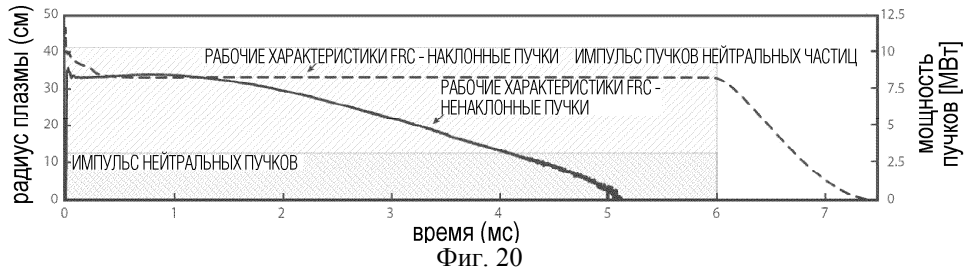




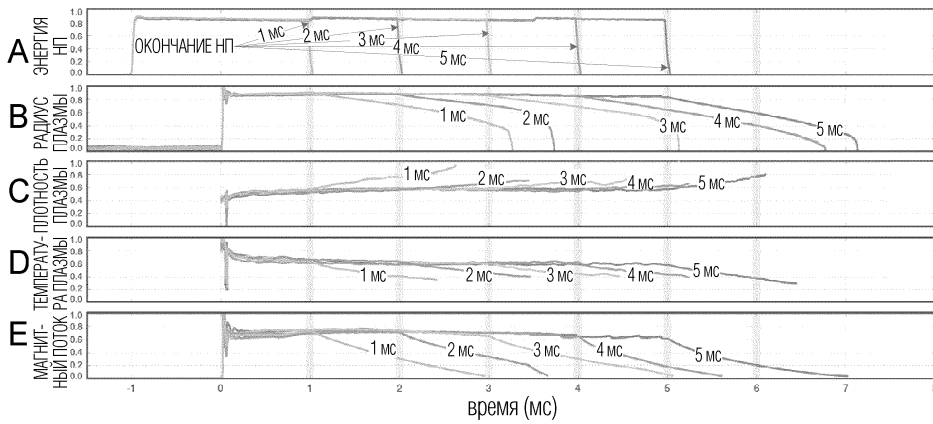
Фиг. 18D



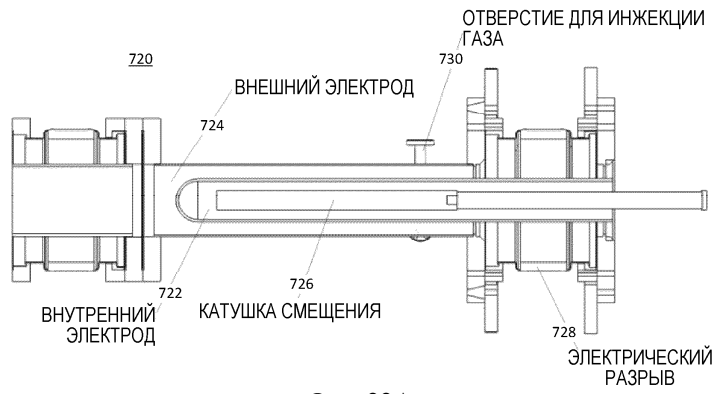
Фиг. 19



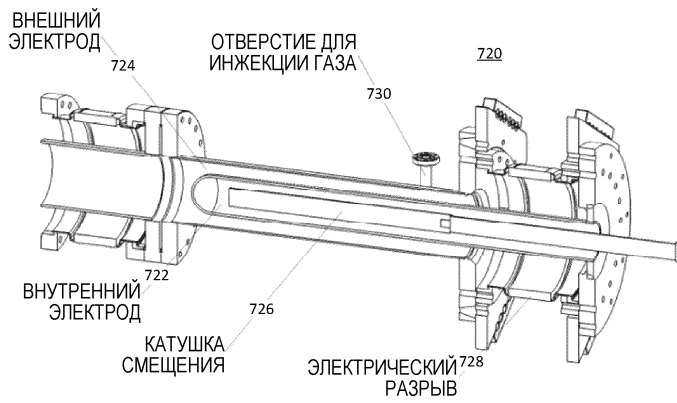
Фиг. 20



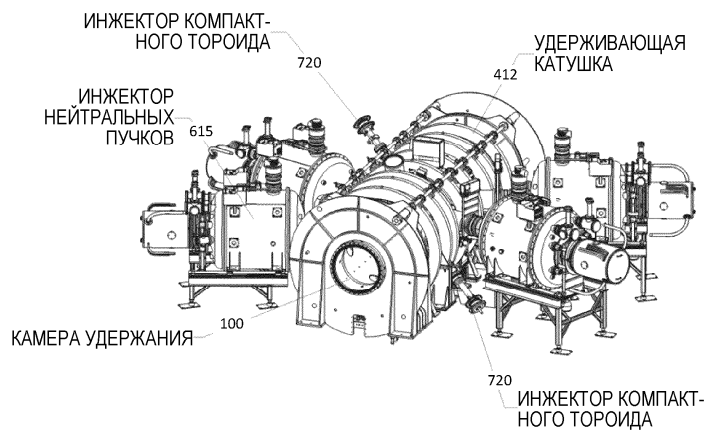
Фиг. 21



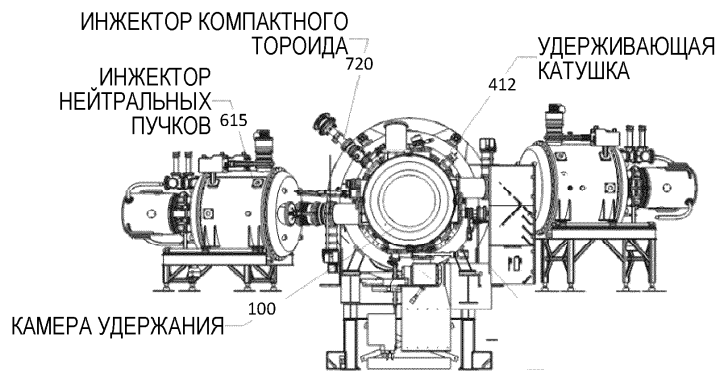
Фиг. 22А



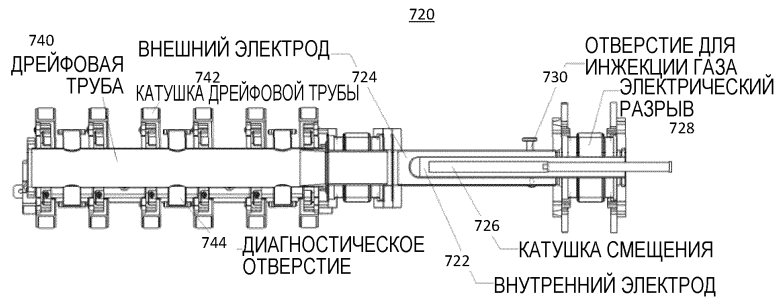
Фиг. 22В



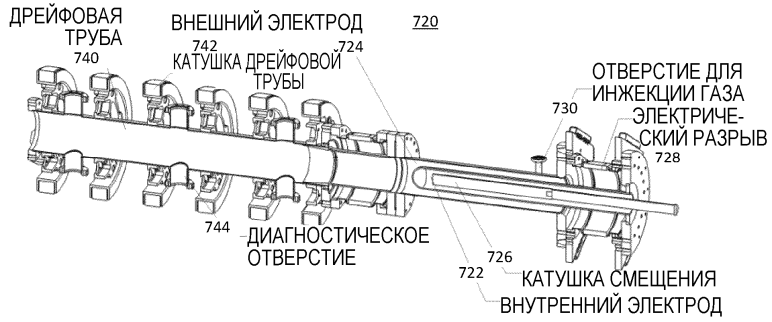
Фиг. 23А



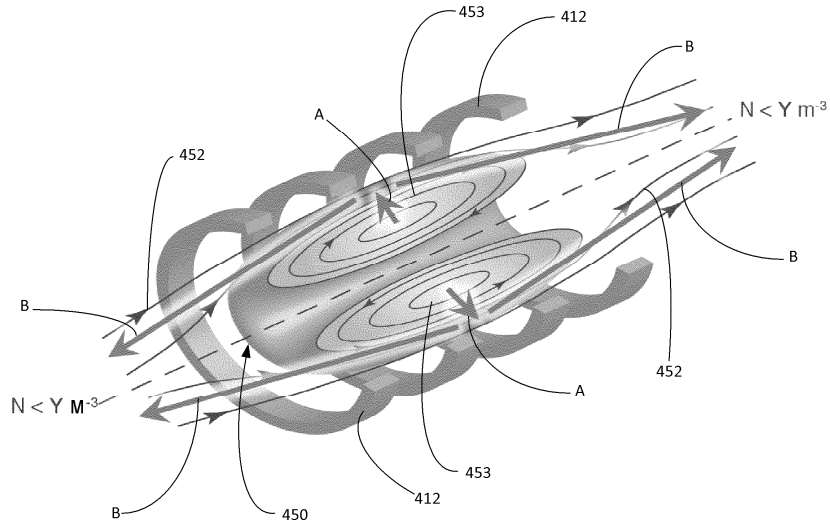
Фиг. 23В



Фиг. 24А

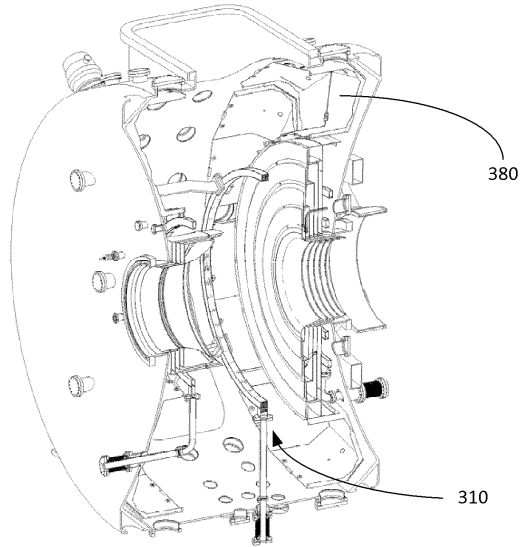


Фиг. 24В

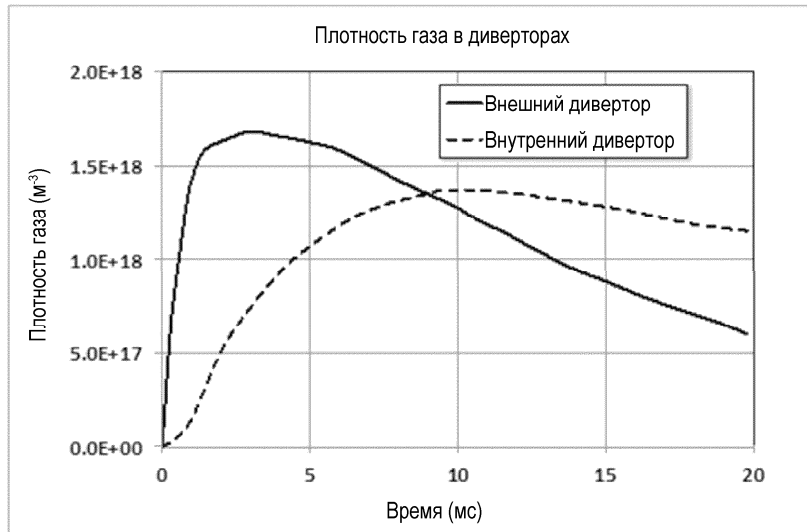


Фиг. 25

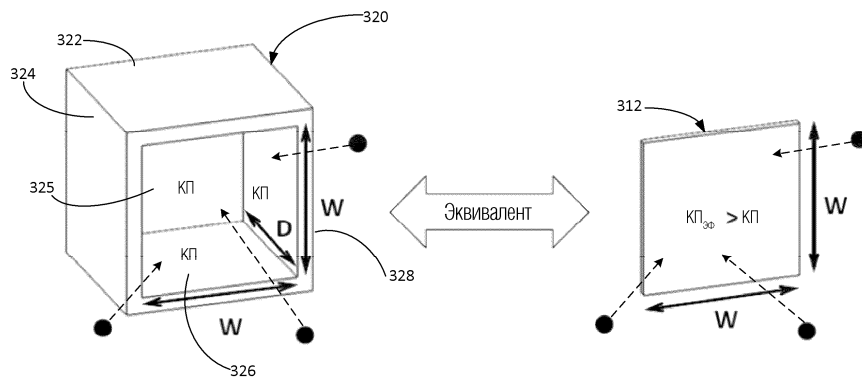
300_302



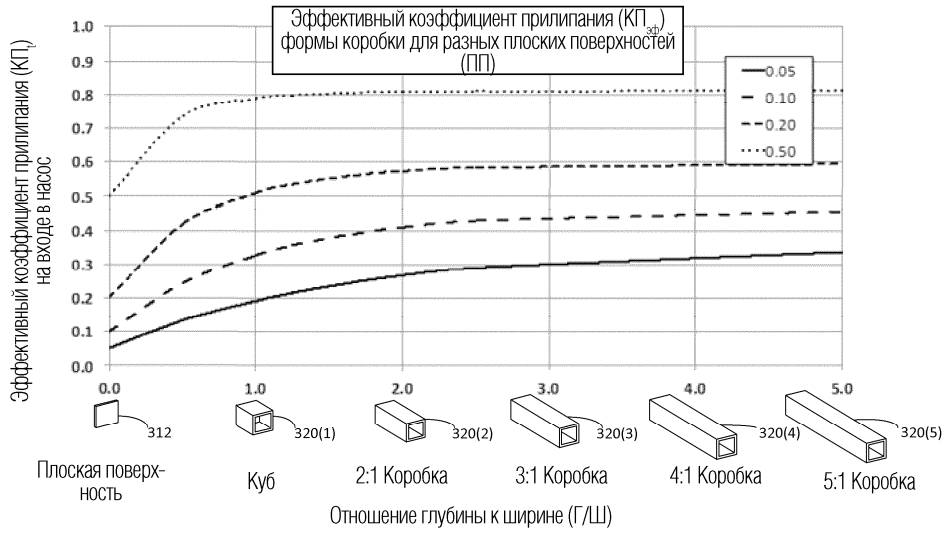
Фиг. 26



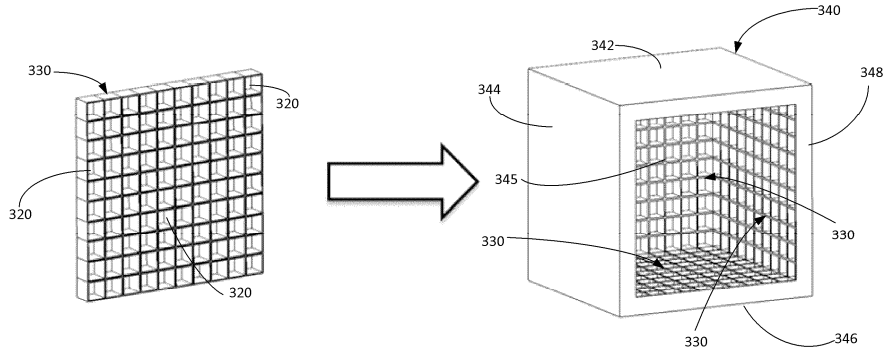
Фиг. 27



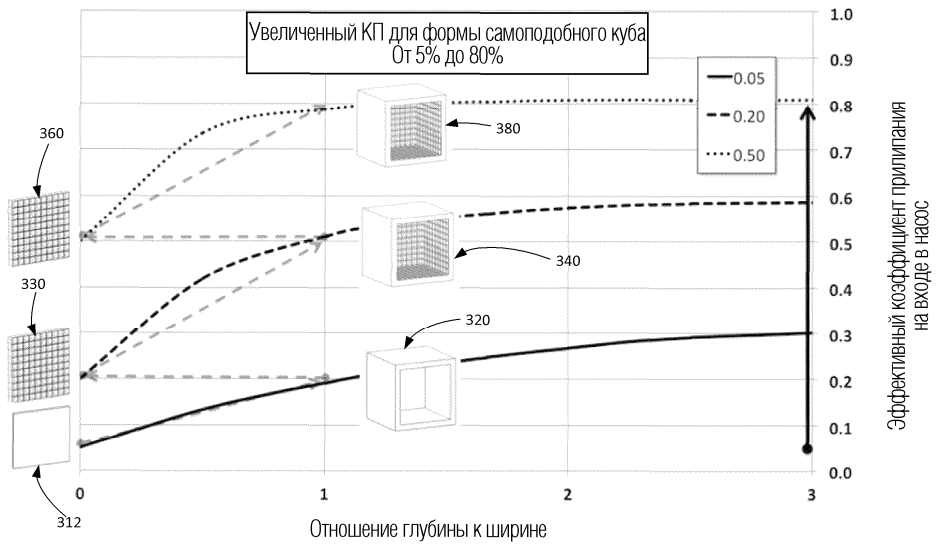
Фиг. 28



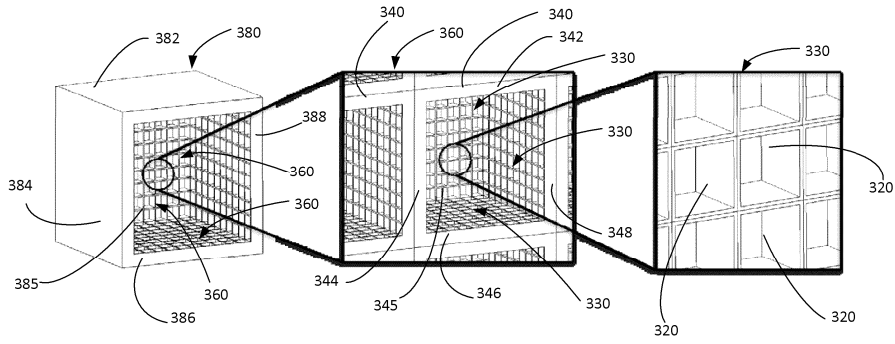
Фиг. 29



Фиг. 30



Фиг. 31



Фиг. 32

